

河北省企业知识产权数据利用指引

目 录

第一章 总则.....	1
第二章 知识产权数据分类.....	2
第三章 知识产权数据获取途径.....	4
一、专利数据获取途径.....	4
二、商标数据获取途径.....	5
三、地理标志数据获取途径.....	5
四、集成电路布图设计数据获取途径.....	6
第四章 知识产权数据利用场景.....	7
一、企业环境.....	7
二、领导作用.....	15
三、策划.....	21
四、支持.....	28
五、运行.....	35
六、绩效评价.....	79
七、改进.....	84

第一章 总则

为贯彻中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，深入推进知识产权强省建设，充分释放知识产权数据价值，解决河北省企业在知识产权数据利用上存在的痛点难点，更好支撑科技创新和产业创新，制定本指引。

本指引所称知识产权数据，是指国家知识产权局公开公布的专利数据、商标数据、地理标志数据和集成电路布图设计数据，具有时效性好、专业性强、规范性佳、利用价值高等特点。

本指引适用于河北省各类企业开展知识产权数据的获取、利用等活动。

企业开展知识产权数据利用工作，应当遵循数据准确、利用便捷、合规使用、操作规范、共享利用的原则。坚持数据来源权威、内容准确完整，确保数据使用无偏差、无缺失；注重利用便捷，提升数据获取与使用过程的简便性、精准性和有效性；严格遵守法律法规及相关数据使用协议，恪守合法合规利用边界；遵循数据标准、技术规范与分析规律，实现操作规范；兼顾数据流动性、传播性等固有属性，积极促进数据在不同主体、不同项目间的共享利用与循环利用。

第二章 知识产权数据分类

本指引所介绍的知识产权数据主要包括专利数据、商标数据、地理标志数据和集成电路布图设计数据，分类见表 1。

表 1 知识产权数据分类

数据分类	数据类型	具体内容
专利	著录项目数据	包括专利名称、申请人、发明人、申请日、公开公告日、IPC 分类号、摘要等著录信息。
	全文数据	包括全文图像、全文文本等数据。其中，发明和实用新型专利全文数据一般包括著录信息、权利要求书、说明书及附图等；外观设计专利全文数据一般包括著录信息、外观设计图片（或照片）和简要说明等。
	公告公报类数据	包括专利公布公告、质押登记公告、许可公告、转让公告、开放许可公告等数据。
	决定裁定类数据	包括复审决定、无效决定、行政复议决定等数据。
	其他文书类数据	包括登记簿、通知书、专利权评价报告、专利意见陈述书等数据。
	专题数据	包括法律状态、引文、分类、索引等数据。
商标	注册基础数据	包括商标基本信息数据、商品/服务数据、代理机构数据、相关人数据、优先权数据等。
	流程类数据	包括与商标效力有关信息、商标权状态、商标审核流程数据等。
	注册证明数据	包括公示商标注册证明和优先权证明、商标变更、转让、续展证明等证明类数据。
	决定裁定类数据	包括异议决定文书、评审文书、注册审查决定文书等数据。
	其他文书类数据	包括注册簿、通知书等文书类数据。

数据分类	数据类型	具体内容
商标	公告公报类数据	包括公告、质押登记公告、转让公告、许可公告等公告公报类数据。
	专题数据	包括集体商标、证明商标、地理标志商标、驰名商标、商标分类等数据。
地理标志	公告类数据	包括地理标志产品初步认定公告、地理标志产品认定公告、地理标志专用标志核准及注销公告等数据。
	其他文书类数据	包括地理标志产品的保护申请、审查认定、撤销、变更以及专用标志的使用管理等数据。
集成电路布图设计	公告类数据	包括集成电路布图设计专有权公告、专有权事务公告、专有权终止公告等数据。
	其他文书类数据	包括登记簿、实施许可合同备案、专有权质押登记等文书类数据。

第三章 知识产权数据获取途径

国家知识产权局向社会公众开放了专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等大量知识产权数据，为知识产权数据的开发利用提供了重要数据基础。

一、专利数据获取途径

专利数据主要通过专利检索及分析系统、外观设计专利检索公共服务系统等途径对外公开。具体途径见表 2。

表 2 专利数据获取途径

系统名称	系统介绍	获取网址
专利检索及分析系统	系统共收集了包括中国、美国、日本、韩国、欧洲专利局、世界知识产权组织在内的 105 个国家、地区和组织的专利数据，同时还收录了引文、同族、法律状态等数据信息。	https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn ¹
外观设计专利检索公共服务系统	提供外观设计专利申请前评估参考、授权后权利稳定性分析、在国内外市场的侵权风险分析、相关领域外观设计专利发展情况分析、业态发展动向跟踪等多维度参考信息。	https://d.cnipa.gov.cn
国家重点产业专利信息服务平台	建有 28 个专利专题产业数据库，具体包括：脑科学、网络通信、氢能和储能等产业。	https://chinaip.cnipa.gov.cn
中国专利公布公告系统	提供专利公布公告数据查询服务，并提供高级查询、IPC 分类查询、LOC 分类查询、事务数据查询等多种查询方式。	http://epub.cnipa.gov.cn
中国及多国专利审查信息查询系统	提供国家知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国知识产权局和美国专利商标局受理的发明专利审查、复审无效审查决定等信息。	https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn

¹ 知识产权数据获取途径的网址仅供参考，以实际登录网址为准，下同。

系统名称	系统介绍	获取网址
知识产权数据资源 公共服务系统	免费开放专利、商标、地理标志和集成电路布 图设计数据。	https://ipdps. cnipa.gov.cn

二、商标数据获取途径

商标数据主要通过中国商标网、欧盟商标查询系统等途径对外公开。具体途径见表 3。

表 3 商标数据获取途径

系统名称	系统介绍	获取网址
中国商标网	可通过中国商标网获取相关商标数据，主要包括商标数据检索查询、商标公告查询、商标注册证明查询，商标注册审查决定文书、商标异议决定文书、商标评审文书查询以及商标数据批量获取。	https://sbj.cn ipa.gov.cn
欧盟商标查询系统	提供欧盟商标信息服务。	https://eutms. gpic.gd.cn
知识产权数据资源公 共服务系统	免费开放专利、商标、地理标志和集成电 路布图设计数据。	https://ipdps. cnipa.gov.cn

三、地理标志数据获取途径

地理标志数据主要通过地理标志产品公告检索系统、专用标志使用企业检索系统、地理标志和官方标志公告模块等途径对外公开。具体途径见表 4。

表 4 地理标志数据获取途径

系统/模块名称	系统/模块介绍	获取网址
地理标志模块	提供地理标志公告、产品及专用标志 使用企业查询服务。	https://www.cnipa.gov.cn /col/col11388/index.html
地理标志产品检 索	由国家知识产权局管理和维护，提供 地理标志产品批准公告查询服务。	https://ggfw.cnipa.gov.c n/d1bzsq/dbQuery

系统/模块名称	系统/模块介绍	获取网址
专用标志使用企业检索	由国家知识产权局管理和维护, 提供专用标志使用企业数据查询服务。	https://ggfw.cnipa.gov.cn/dlbzsq/zybzqyQuery
地理标志和官方标志公告模块	由国家知识产权局管理和维护, 提供地理标志和官方标志公告信息。	https://www.cnipa.gov.cn/col/col12089/index.html
中国商标网	提供以集体商标、证明商标注册的地理标志注册信息查询服务。	https://sbj.cnipa.gov.cn
知识产权数据资源公共服务系统	免费开放专利、商标、地理标志和集成电路布图设计数据。	https://ipdps.cnipa.gov.cn

四、集成电路布图设计数据获取途径

集成电路布图设计数据主要通过集成电路公告模块、知识产权数据资源公共服务系统等途径对外公开。具体途径见表 5。

表 5 集成电路布图设计数据获取途径

系统/模块名称	系统/模块介绍	获取网址
集成电路公告模块	由国家知识产权局管理和维护, 提供集成电路布图设计专有权公告、专有权事务公告、专有权终止公告等信息。	https://www.cnipa.gov.cn/col/col1164/index.html
中国知识产权报	版权综合、版权专题等版面提供专有权及专有权事务公告等信息。	https://sz.iprchn.com/bz/html/index.html
知识产权数据资源公共服务系统	免费开放专利、商标、地理标志和集成电路布图设计数据。	https://ipdps.cnipa.gov.cn

第四章 知识产权数据利用场景

普及知识产权数据利用场景和方式是促进数据价值发挥和提升数据利用效率的重要途径。本指引围绕企业环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进七大管理过程，细化各过程知识产权数据利用的具体场景与方式，旨在推动知识产权数据从被动查询向主动赋能转变，为企业高质量发展提供有力支撑。

一、企业环境

（一）理解企业及其环境

1. 利用目的

通过检索与分析知识产权数据，可以系统把握企业内部环境（如企业产品或服务所涉及的核心技术、知识产权状况等）与外部环境（如所处产业的市场环境、法律环境等），从而为企业战略定位提供数据支撑。

2. 利用方式

（1）理解企业内部环境

① 专利数据

a. 专利检索

通过专利检索，获取本企业产品或服务涉及的核心技术动向、专利数量及状态等信息，掌握自身专利状况，把握核心技术发展趋势。

b. 专利分析

技术发展分析：分析特定技术领域的专利布局、申请趋势、

IPC分类号及核心专利被引证情况,获取该领域的技术演进路径、研究热点及未来发展方向等,判断自身的技术路线是否符合行业发展趋势,识别是否存在技术落后或偏离主航道的潜在风险。

专利状况分析:分析自身专利的申请趋势、CPC/IPC 分类分布、法律状态、发明人排行等,获取自身的核心技术和边缘技术,了解自身的高产发明人、专利资产等。明确自身在行业中的创新地位,掌握自身专利的法律状态和价值,制定或调整创新团队的人力资源规划。

② 商标数据

a. 商标检索

通过商标检索,获取自身商标数量及法律状态等信息,掌握自身商标状况、降低法律与合规风险等。

b. 商标分析

技术分析:分析商标对应产品/服务的技术属性、商标与技术迭代的关联性等信息,把握商标与技术融合的发展趋势,了解技术发展对品牌竞争的影响。

商标状况分析:分析自身商标注册覆盖范围、显著性与独特性、使用合规性、侵权风险等,综合评估自身商标法律保护强度与稳定性,明确品牌优化与延伸风险。辅助企业制定针对性的商标注册补全策略与合规使用方案,规避商标侵权与被侵权风险,强化品牌市场竞争力。

③ 地理标志数据

a. 地理标志检索

查询地理标志产品认定公告、商标公告、地理标志专用标志使用企业名录等公开信息，获取地理标志产品保护要求、本企业专用标志授权信息等，明确自身地理标志状况、降低合规风险。

b. 地理标志分析

地理标志状况分析：分析自身地理标志授权使用资质、使用合规性、产品与地理标志产品保护要求的契合度等，评估自身依托地理标志的合规运营水平，优化产品品质与合规使用流程，规避地理标志使用风险。

④集成电路布图设计数据

a. 集成电路布图设计检索

通过集成电路布图设计专有权公告及专有权事务公告信息，获取登记号、申请日期、公告日期、公告号、布图设计名称、权利人/原权利人、创作人、创作完成日、著录项目变更等数据，掌握自身布图设计信息。

b. 集成电路布图设计分析

技术分析：围绕布图设计架构类型、工艺技术水平、技术创新点、与上下游技术兼容性等核心维度开展分析，把握核心技术的发展方向与创新趋势，明确布图设计技术升级路径、技术迭代趋势与技术竞争焦点，评估自身布图设计技术先进性与兼容性。

集成电路布图设计状况分析：针对自身布图设计登记数量与保护范围、技术先进性与市场适配性、与专利协同保护效果、侵

权风险等关键内容进行研判，评估自身布图设计技术价值、合规风险与商业化潜力，明确优化与升级方向。

（2）理解企业外部环境

①专利数据

a. 专利检索

通过专利检索，获取产业发展趋势、核心技术动向、法律风险等信息，分析技术发展态势、预测市场走向，评估竞争压力。

b. 专利分析

产业分析：围绕特定产业专利的申请数量、申请人分布、法律状态等信息开展分析，获取该领域的创新活跃度、市场集中度及竞争格局，明确领域内核心创新主体，评估新市场进入的可行性，研判创新方向是否需要调整。

法律环境分析：分析专利的技术分类、申请地区、争议主体、申请人、代理机构等信息，获取特定地区、特定技术领域的法律执行和审查倾向，以及不同申请人、代理机构对专利质量的重视程度。高质量专利的申请人可作为潜在合作伙伴。

②商标数据

a. 商标检索

通过商标检索，获取行业头部企业及新兴企业的商标注册数据，评估目标市场竞争格局、降低合规风险等。

b. 商标分析

产业分析：分析产业商标集中度、区域产业商标布局、产业

细分领域商标分布等，明确产业商标竞争格局与区域商标优势，挖掘产业链商标协同发展潜力，把握产业商标发展趋势，优化商标在产业链中的定位。

③地理标志数据

a. 地理标志检索

以地理标志名称、公告号为关键词对地理标志公告、商标公告进行检索，获取产地范围、感官特色、理化指标等质量要求数据，了解同类产品中地理标志产品或商标的相关信息。

b. 地理标志分析

产业分析：获取地理标志所属产业的市场环境数据（如产业饱和度、市场竞争格局、地理标志产品的产值等）、产业技术发展趋势数据（如地理标志产品加工技术升级方向），识别地理标志所属产业发展的外部机遇与挑战。

法律环境分析：检索地理标志申请、专用标志管理相关规定，以及地方产业政策、国家产业规划中涉及地理标志的相关要求，明确地理标志合规管理的外部约束。

④集成电路布图设计数据

a. 集成电路布图设计检索

检索集成电路布图设计专有权公告及专有权事务公告等信息，获取登记号、申请日期、公告日期、公告号、布图设计名称、权利人/原权利人、创作人、创作完成日、著录项目变更等数据，掌握竞争对手或合作伙伴已有专利权的布图设计信息。

b. 集成电路布图设计分析

围绕集成电路布图设计技术分布、核心环节竞争格局、区域产业集群等多个维度展开分析，把握核心技术的发展方向与创新趋势，明确产业链各环节竞争焦点、区域产业集群优势。制定产业链合作方向、技术布局短板及协同保护策略等。

（二）识别相关方的信息

1. 利用目的

通过数据掌握相关方（合作伙伴、竞争对手）的知识产权状况、核心技术及权利稳定性等，为制定合作或竞争策略提供依据。

2. 利用方式

（1）专利数据

①专利检索

以合作伙伴/竞争对手名称、法定代表人、核心研发人员姓名为关键词，检索其名下专利，掌握其核心专利的法律状态、同族专利全球布局及引证关联信息。

②专利分析

相关方专利状况分析：分析相关方专利持有量、申请人类型、联合申请合作情况、专利跨领域布局广度等，判断相关方创新实力、技术专注度、协同合作意愿与资源整合能力。优先选择专利储备充足、技术专注度高、协同合作经验丰富的合作伙伴。

技术分析：分析相关方的专利技术分类、技术路线演进轨迹、核心专利创新强度、核心专利引证、关键技术布局领域等，明确

其核心技术优势、技术迭代速度、重点技术研发方向，判断其技术创新的可持续性与领先性。据此筛选技术领域互补、核心技术匹配的潜在合作伙伴，识别在关键技术领域存在竞争的对手。

权利稳定性分析：梳理相关方专利的法律状态、专利诉讼与无效案例记录、权利要求保护范围清晰度等信息，评估其专利资产的法律稳定性、维权能力与潜在法律风险。规避与专利法律状态不稳定、存在侵权纠纷记录的相关方合作，降低合作风险。

（2）商标数据

① 商标检索

检索相关方商标注册清单，排查是否存在与本企业品牌近似的商标；梳理其商标使用授权情况及相关纠纷记录，明确相关方商标权属，确认其是否具备商标授权他人使用的权利，并厘清相应授权范围。

② 商标分析

相关方商标状况分析：分析相关方的商标持有量、跨类别/跨地域布局策略等信息，判断相关方的商标战略规划水平，优先选择商标布局完善的合作伙伴。

技术分析：分析相关方商标对应产品/服务的技术属性，判断其商标技术赋能方向、技术驱动型商标运营策略及商标技术适配契合度。筛选技术属性匹配、品牌技术运营规范的合作伙伴，识别依托新技术布局品牌的竞争对手。

权利稳定性分析：梳理相关方商标的注册覆盖范围、驳回/

异议/无效记录、侵权纠纷诉讼情况、商标合规使用记录等信息，评估其商标的保护强度、合规运营水平、品牌维权能力与潜在法律风险。筛选商标法律状态稳定、运营合规的相关方。

（3）地理标志数据

①地理标志检索

以相关方名称为关键词检索专用标志使用企业，获取相关方的地理标志信息。

②地理标志分析

权利稳定性分析：重点分析相关方的地理标志授权使用资质、合规使用记录，评估其地理标志合规运营水平。规避与无合法授权资质、存在违规使用记录的相关方合作。

（4）集成电路布图设计数据

①集成电路布图设计检索

基于集成电路布图设计专有权及事务公告检索，查询相关方的布图设计登记数量、技术类型、授权使用范围、技术相似度、保护期限、侵权投诉记录等。

②集成电路布图设计分析

相关方布图设计状况分析：分析相关方的布图设计持有量、跨领域布局、技术迭代周期、布图设计专有权剩余期限等，明确其创新实力与技术布局战略，分析其市场快速响应能力。识别布图设计储备充足、合作经验丰富、技术迭代速度快及布局激进的相关方。

技术分析: 分析相关方的布图设计架构类型、工艺技术水平、技术创新点等信息, 明确其核心技术实力、技术迭代速度、产品适配能力与创新潜力。筛选技术参数匹配、兼容性强的合作伙伴, 识别在核心技术领域具有领先优势的竞争对手。

权利稳定性分析: 梳理相关方的布图设计登记情况、侵权诉讼记录、合规使用记录、跨境保护布局等信息, 评估其布图设计法律保护强度、合规运营水平、跨境维权能力与潜在法律风险。重点识别未登记布图设计、存在侵权记录的相关方。

二、领导作用

(一) 最高管理者职责

1. 利用目的

结合企业环境分析, 制定企业知识产权方针、目标并策划其实现路径, 配备人员、财务及信息等资源, 并实施管理评审等。

2. 利用方式

(1) 专利数据

方针与目标制定: 基于专利数据分析报告, 掌握特定技术领域的技术分支、技术路线、重点专利及侵权风险等信息, 结合企业自身专利现状与行业竞争格局, 制定或调整与企业整体战略协同的专利布局方针, 设定专利申请数量、质量及全球布局覆盖度等阶段性目标及实现策划。

资源配备决策: 依据专利布局与预警分析报告研判的风险等级与战略缺口, 审批与之匹配的人员增补计划、财务预算及内外

部专业服务机构的合作资源配置。

管理评审实施：依据专利全生命周期管理数据与绩效评价结果，开展专利管理评审，评审现行专利体系对技术创新与市场保护的适宜性与充分性，做出战略调整决策。

（2）商标数据

方针与目标制定：基于商标布局与市场分析报告，明确品牌识别、传播与市场拓展的法律支撑需求，制定商标保护布局方针，设定商标注册类别补齐、海外布局延伸及品牌资产价值提升的具体目标及实现策划。

资源配备决策：结合商标注册维护成本、品牌价值与市场拓展需求，确保商标管理所需人员、专项财务及商标信息资源配备。

管理评审实施：结合商标管理成效、风险防控数据，实施商标管理评审，决策是否启动品牌架构重组或策略优化。

（3）地理标志数据

方针与目标制定：基于地理标志相关分析报告与产业态势，制定企业地理标志合规使用与价值提升的管理方针，设定专用标志申请获取、品质管控达标及产品溢价提升的目标及实现策划。

资源配备决策：结合地理标志申报、运营、品控等工作需求，配置专属管理人员、专项财务资金及溯源信息资源等。

管理评审实施：结合地理标志使用合规性、品牌效益等数据，开展地理标志管理评审，优化使用规范与品质管控流程。

（4）集成电路布图设计数据

方针与目标制定: 基于布图设计技术、竞争与资产分析报告, 掌握领域技术壁垒、市场需求与企业自身短板, 制定芯片设计成果“应登尽登”的保护方针, 设定核心布图设计登记量、技术自主化率及 IP 资产商业化收益等战略目标及实现策划。

资源配备决策: 结合布图设计登记、维权、研发投入需求, 统筹设计人员编制、财务资源及布图设计信息资源等配备。

管理评审实施: 结合布图设计资产对核心芯片产品的技术贡献度、对外授权收益等数据, 实施管理评审, 完善布图设计全流程管理体系。

(二) 管理者代表职责²

1. 利用目的

基于绩效评价、改进等过程的分析结果, 管理者代表向最高管理者报告知识产权合规管理体系运行绩效及改进需求; 落实运行、改进过程所需的人员、财务、信息等各项资源。

2. 利用方式

(1) 专利数据

汇总专利申请量、授权率、有效率、合规风险发生率、维权成效等数据, 评估运行绩效, 识别短板并提出改进需求, 上报最高管理者。结合专利管理工作量、风险等级、布局需求、成本支出等数据, 落实人员配置、财务预算及专利信息资源等。

(2) 商标数据

² 管理者代表由最高管理者授权, 一般在企业管理层负责知识产权管理、合规管理或其他管理的人员中指定。

统计商标注册成功率、合规使用率、风险处置率、品牌保护效果等数据，评价体系绩效，挖掘问题并明确改进方向，上报最高管理者。结合商标注册、监测、维权、合规管理等工作数据，落实专职人员、专项财务资源，搭建商标信息管理支撑条件等。

（3）地理标志数据

梳理合规使用率、品质达标率、品牌效益等数据，评估运行成效，提出合规管理改进建议，向最高管理者汇报。结合申报、使用、品控、监管等工作数据，落实专职人员、专项财务资金，配置地理标志数据信息资源。

（4）集成电路布图设计数据

梳理登记率、原创性合规率、风险防控率等数据，评价体系运行效果，明确保护与管理改进需求，向最高管理者汇报。结合登记、合规、排查、维权等工作数据，落实专职人员、专项财务资金，配备布图设计信息资源与系统。

（三）知识产权管理机构职责³

1. 利用目的

负责企业知识产权日常管理工作；建立专利导航工作机制，为重大项目知识产权布局提供精准数据支撑，保障工作有序推进。

2. 利用方式

（1）负责知识产权日常管理工作

常态化开展知识产权数据的归集、核验、更新、归档与台账

³ 并非所有企业都创建独立的知识产权管理机构，一些企业将相关职责分配至现有岗位。

管理，协调财务、人力、法务等部门依据数据优化知识产权预算、人员配置及培训计划等。

（2）建立专利导航工作机制

搭建专利导航基础数据库，明确数据采集标准、动态更新频次与内部共享流程，搭建企业内部知识产权数据应用系统，完成各类知识产权数据的格式化、分类标引与整合处理。

（3）参与重大项目知识产权布局

①专利数据

a. 项目可行性评估与技术路径规划阶段

分析项目目标技术领域的全球专利布局态势，包括主要技术分支的专利数量与法律状态、核心专利的权利要求范围、竞争对手的专利组合强度及技术发展路线图等，识别项目潜在的专利壁垒和侵权风险等级，评估技术路线的自由实施可能性，挖掘技术合作机会及可规避设计空间，进一步锁定具备自主知识产权布局潜力的技术创新方向。

b. 项目研发与成果保护阶段

动态跟踪项目研发过程中产生的技术成果，结合在先专利开展比对分析（即专利性检索与FTO补充分析），同时监测竞争对手在相关领域的专利申请动态。评估项目自身创新成果的可专利性，制定专利申请策略，及时预警研发过程中新出现的侵权风险。

c. 项目产业化与市场竞争阶段

分析项目产品目标市场的专利竞争环境、主要竞争对手的核

心专利包、相关领域的专利诉讼与许可案例等信息，评估产品上市后的潜在风险，识别可能发起诉讼的非专利实施主体（NPE）或竞争对手，为制定市场进入策略、产品定价以及可能的专利交叉许可或无效宣告提供数据支持。

② 商标数据

a. 项目商标品牌战略与市场进入规划阶段

围绕项目产品或服务拟定的名称与标识，分析其在目标市场的注册可能性，排查在先相同或近似商标，研究当地审查实践与消费者认知习惯。评估商标注册的核心障碍与成功率，提供可安全使用的商标名称建议，规划商标注册的类别、地域和申请路径。

b. 项目推广与商标培育阶段

监测商标在申请与使用过程中面临的异议、无效宣告等法律问题，以及市场上的假冒、侵权等情况。及时发现并评估针对商标的法律与商业风险，为应对争议、维护商标权提供建议。

③ 地理标志数据

a. 涉农或特色产业项目开发阶段

分析项目所涉及的产品是否符合地理标志保护要求，研究同类产品地理标志的成功运营模式、管理规则及经济效益。判断项目产品申请或关联地理标志的可行性与价值，明确申报流程等。

b. 供应链与品质管控体系建设阶段

梳理地理标志产品/商标要求的特定生产工艺、原料来源及质量管控体系，判断本企业申请专用标志的可行性。明确项目若

使用专用标志需遵循的生产规范和质量标准，识别供应链中需要加强管控或开展产品认证的环节。

④集成电路布图设计数据

a. 项目立项与研发阶段

聚焦项目拟设计芯片所属领域的在先布图设计登记情况与主要厂商设计方案，开展不侵权分析。预警芯片设计可能侵犯他人布图设计专有权的潜在风险，为原创设计或规避设计提供依据。

b. 完成与产品化阶段

评估项目产生布图设计的独创性及商业价值，分析目标市场的保护需求，明确需要提交登记的布图设计清单、登记策略及目标登记国家/地区。

三、策划

（一）目标策划

1. 利用目的

结合企业环境、改进等过程的分析结果，由最高管理者策划并设定知识产权目标。

2. 利用方式

基于知识产权数据分析，设定目标：

（1）专利数据

①专利检索

检索同行业核心技术的专利申请量、授权率、高价值专利占比、技术转化率等数据，同时检索本企业专利历史数据，梳理本

企业近年来专利申请增长趋势、授权质量、技术分布特征等信息。

②专利分析

技术方向分析：分析特定技术领域 IPC/CPC 分类的专利数量、申请趋势、授权量等数据，识别技术热点和空白点，判断细分技术所处的生命周期，把握主流技术路线及潜在技术方向。

申请人分析：分析同行业主要申请人的专利数量、IPC/CPC 分类、申请趋势、发明占比等数据，将本企业专利数据与行业龙头或关键竞争对手专利数据进行多维度对标。发现竞争对手的技术优势、短板及潜在合作伙伴，明确自身在行业中的竞争地位，识别自身在技术覆盖、专利质量、创新能力等方面的优势与差距。

重点专利分析：聚焦特定技术分支内高被引证专利、标准必要专利、多次诉讼专利等，分析其保护策略、专利质量与技术稳定性；结合技术、法律、市场等维度，分析重点专利的价值。识别具有关键支撑作用的高价值专利，与高价值专利对比评估自身的创新产出效能，并识别具备许可、转让或质押融资潜力的专利。

法律状态与权利稳定性分析：动态监控目标技术领域专利的失效、届满、转让、质押等情况，开展专利壁垒与自由实施（FTO）分析，筛查可能阻碍本企业技术实施的关键专利。识别已进入公有领域、可供技术借鉴或改进的失效专利，预警可规避或需获取许可的技术风险。

③设定目标

一方面，设定具有挑战性且可实现的专利申请数量、质量（如

发明专利占比）及布局广度（如海外申请）目标。另一方面，将识别出的技术空白点转化为具体的研发项目。

（2）商标数据

①商标检索

检索同行业头部企业的商标注册量、授权率等数据，同时检索本企业商标历史数据，梳理近年来商标注册增长趋势、授权质量情况及本企业现有业务对应的商标类别缺口数据等信息。

②商标分析

自身商标状况分析：梳理本企业商标注册覆盖范围，评估其显著性、独特性与业务场景的匹配程度，分析潜在冲突风险，掌握商标现状，明确优化路径与延伸方向。

市场与竞争分析：分析目标市场内相关类别商标的申请活跃度、主要竞争者的布局策略与延伸动向、异议与争议领域等信息，掌握市场竞争强度与消费者认知动态，识别商标注册的“红海”与“蓝海”领域，预警潜在注册冲突与商标共存风险。

③设定目标

结合商标数据、本企业商标布局现状及市场拓展计划，设定兼具挑战性与可实现性的商标注册阶段性目标，涵盖注册类别、时间规划及布局广度（含海外布局）。

（3）地理标志数据

①地理标志检索

检索本企业所在地区的地理标志产品、商标及专用标志使用

主体信息，掌握同地区地理标志情况。

②地理标志分析

自身关联度评估：分析本企业产品、原料或品牌是否具备或关联特定产地特征，评估符合地理标志专用标志使用资质的程度。明确是否将获取地理标志专用标志或与地理标志建立关联纳入知识产权目标，并规划实施路径。

产业与区域发展分析：分析特定区域内地理标志的产业集聚效应、相关产品的市场溢价与规模、产业链上下游企业分布等情况。若本企业位于该产地范围，可设定申请或使用地理标志作为提升产品价值与市场竞争力的具体目标；若为外部投资者，则可识别基于地理标志的产业投资与合作机会。

③设定目标

结合地理标志分析结论与业务发展规划，制定地理标志专用标志申请或使用的目标。

（4）集成电路布图设计数据

①集成电路布图设计检索

通过集成电路布图设计公告，检索并汇总同行业头部企业的布图设计登记量等数据，查询本企业近年来布图设计登记申请趋势、授权情况等信息。

②集成电路布图设计分析

技术发展分析：分析不同类型芯片的布图设计登记趋势、设计最小线宽等关键技术与工艺节点的关联，把握集成电路设计的

技术演进方向与热点应用领域，了解不同设计方案的竞争态势。明确产品规划、研发重点以及前瞻性布局方向。

成果保护分析：梳理本企业自身布图设计的登记情况，分析其与产品系列的对应关系及核心设计的创新水平，评估现有保护体系的完整性，识别核心资产与保护薄弱环节。

③ 设定目标

基于分析结果，设定核心布图设计“应登尽登”的量化目标，并针对关键产品，规划多层次、组合式的布图设计保护策略。

（二）目标实现策划

1. 利用目的

根据知识产权目标，由最高管理者策划目标实现路径，明确资源投入与风险应对措施。

2. 利用方式

（1）确定目标实现方法

① 专利数据

技术路径与竞争态势的路线选择分析：分析实现技术目标的不同路径、每条路径的专利壁垒分布、主要权利人及其许可情况，以及竞争对手在这些路径上的布局情况。比较各技术路径的实现难度、专利壁垒强度和竞争强度，识别出可行的技术攻关路线，明确是否需要合作/许可。

自由实施（FTO）与风险应对的策略规划分析：针对选定的技术路径和拟开发的产品，进行FTO分析，识别实施过程中可能

侵犯的具体专利、风险等级及权利人特点等信息，明确哪些风险可通过设计规避消除，哪些需通过许可谈判解决，哪些可能需要发起无效宣告作为备用方案。

②商标数据

市场进入策略与法律障碍的解决方案分析：分析目标市场内品牌注册的主要法律障碍的具体情况，如权利人状态、商标使用情况、历史争议记录等。评估通过协商、法律行动或商业交易等方式清除障碍的可能性与成本。

③地理标志数据

专用标志申请与合规使用分析：若本企业无地理标志专用标志使用资质，可向地理标志保护产品批准公告中确定的市场监管机构提出申请，并提供申请材料。若已获得使用资质，需常态化开展产品质量管控与专用标志使用合规自查。

④集成电路布图设计数据

设计安全与效率平衡的保护方法选择：分析芯片设计中不同模块的技术特性及可能的商业化模式，对不同模块采取差异化知识产权保护方法的建议：对核心且难反向的模块，可采用技术秘密保护；对易反向或计划对外授权的模块，可采用布图设计登记保护；对通用性模块，可采用防御性公开或开源保护策略。

（2）优化资源配置

①专利数据

预算优化分析：梳理每件专利的法律状态、剩余保护期限、

年费成本等信息，评估其与核心产品和技术的相关度、法律稳定性及潜在的市场/许可价值，形成按价值和风险分级的专利资产清单，量化每年在维护低价值或高风险专利上的固定支出，识别出资源投入与产出严重不匹配的负资产领域。

投入效能分析：分析不同研发团队或业务单元的专利产出效能（如专利申请/授权量、专利质量评分等），并与其在核心技术路线上的战略重要性进行比对。识别出专利创造效能较高的团队和服务方，明确哪些技术领域需要加强内部专业支持或寻求更优的外部合作。

② 商标数据

投入产出比分析：按国家和类别，统计商标注册与维护的历史总成本，并结合该国家/地区的市场销售收入、实际面临的侵权风险及维权成本进行综合分析，量化评估在不同市场进行商标布局与保护的效益比，识别出高投入低回报或高风险低投入的资源配置失衡区域。

③ 地理标志数据

资源投入分析：分析本企业为遵守地理标志保护要求（如使用特定品种、遵循传统工艺、落实产品质量检测等）所增加的额外生产成本，并与认定地理标志产品/商标后带来的市场溢价和销量增长进行对比，评估并优化资源投入比例。

④ 集成电路布图设计数据

登记策略优化分析：分析在不同国家/地区进行布图设计登

记的成本构成，并结合产品在该市场的销售计划、竞争强度、法律保护力度及侵权诉讼历史数据，将资源集中投入到核心产品、主要销售市场和诉讼高风险地区。

（3）制定风险应对措施

①专利数据

开展专利预警分析识别核心技术领域的侵权风险，利用竞争对手调查分析制定竞争应对策略，制定侵权风险应对措施、专利无效应对措施，建立风险预警机制等。

②商标数据

通过商标监测发现近似商标抢注风险、商标侵权风险。结合市场调研，分析行业风险案例，制定注册驳回应应对措施、抢注应对措施、侵权应对措施等。

③地理标志数据

结合政策法规，通过地理标志分析应对政策变化风险，防范地理标志申请驳回风险、违规使用风险。分析行业风险案例，制定申请驳回及违规使用的应对措施等。

④集成电路布图设计数据

通过集成电路布图设计分析，识别布图设计抄袭风险、授权到期风险、登记驳回风险，制定技术风险防控方案、抄袭应对措施、授权到期应对措施以及登记驳回应应对措施等。

四、支持

（一）人员

1. 利用目的

通过分析知识产权数据，掌握员工的知识产权背景与专业技术能力，为知识产权合规管理体系的有效运行提供支撑。

2. 利用方式

（1）专利数据

①入职阶段

开展人才管理分析，在人才引进环节利用专利检索寻找目标人才，并对其涉及的专利进行评价。检索入职人员既往参与的专利项目，核查专利权属是否清晰、有无职务发明纠纷记录，评估人才的技术创新能力、专业领域，规避潜在法律风险。

②在职阶段

通过专利检索，统计员工参与的专利申请量、授权量、核心专利数量、专利转化效益，量化员工的创新贡献，识别核心研发人员。检索分析结论可以作为薪酬激励与晋升评定的参考依据。

定期监测和分析在职员工作为发明人的新专利申请活动，重点关注申请主体、技术领域是否与本职工作或企业明确分配的任务相关，排查未经企业许可的对外申请或合作申请。实时掌握员工的技术产出动态。

③离退阶段

核查离职员工职务发明清单，明确职务发明权属；持续监测员工在竞业限制期内的专利申请行为，重点核查其申请专利所属技术领域是否与本企业业务形成竞争、申请主体是否为竞争对手

企业。预警员工违反竞业限制或保密协议、利用本企业技术成果为竞争对手或自行创业提供技术支持的风险。

（2）商标数据

①入职与在职阶段

分析高管、市场或品牌部门员工是否以个人或其他关联实体名义，在与本企业业务相关的类别上申请注册或持有商标，尤其是与本企业商标近似或相关的标识。识别员工不当注册或占用企业商标资源的行为。

②离退阶段

监测离职员工在离职后是否立即注册或使用与本企业商标近似的标识，或加入竞争对手后参与相关的品牌活动。预警离职员工可能利用其掌握的商标战略、渠道关系等进行不正当竞争的风险，如抢注商标、误导客户等。

（3）地理标志数据

①入职与在职阶段

核查负责地理标志产品/服务生产、品控、营销的核心员工，是否同时在其他被许可使用该地理标志的企业任职，评估员工行为是否存在利益冲突，是否可能泄露或不当使用地理标志特有的生产工艺、管理标准及客户信息等。

②离职阶段

核查离职员工是否在离职后违反约定，向非授权方泄露本企业地理标志产品的核心生产技术、秘方或质量控制细节，或协助

非授权方生产仿冒产品。识别地理标志特有信息被不当扩散或非法利用的风险点。

（4）集成电路布图设计数据

①入职阶段

分析拟入职员工过往作为设计人登记的布图设计成果，核实其成果与前雇主的权属关系，预警其可能带来与前雇主之间的布图设计权属纠纷。了解拟入职员工专长技术领域，评估其技术能力与经验真实性，并判断其技术背景与当前项目的匹配度。

②在职阶段

监控核心设计人员作为创作人登记的布图设计，确保登记主体为本企业，并分析其设计产出是否与项目任务相符，确保所有职务布图设计成果的产权归属于本企业，及时发现任何未经授权的个人登记或为外部进行登记的行为。

③离退阶段

在员工离职前，核对其参与的布图设计项目清单与登记情况。离职后，监测竞业限制期内其在新单位是否有与本企业技术方案高度近似的布图设计登记。确保所有参与项目的设计成果已完成内部交接与权属锁定，预警技术泄密或侵权风险。

（二）财务资源

1. 利用目的

明确知识产权获取、维持、诉讼等事项所需财务资源并予以保障，确保资金投入与知识产权目标相匹配。

2. 利用方式

（1）专利数据

成本与资产价值分析：分析专利申请、审查、授权、年费维持、国际布局等各环节的历史成本数据，同时评估专利的许可收入、质押融资价值、诉讼赔付或和解金额，以及专利为产品带来的市场溢价或防御性价值。量化不同技术领域、不同国家、不同法律状态的专利全生命周期成本；识别高维护成本但低商业价值的休眠专利或问题专利，为后续运行与绩效评价等阶段提供依据。

风险与诉讼应对分析：分析特定技术领域专利诉讼的平均成本、和解金额范围，以及主要竞争对手或非专利实施实体（NPE）的诉讼活跃度与策略。评估本企业在不同业务领域面临的潜在专利诉讼财务风险等级，预测法律纠纷可能产生的费用范围。

（2）商标数据

注册、维护与维权成本分析：分析全球主要目标市场的商标申请费、代理费、续展及监测成本，同时统计应对侵权行为的行政投诉、诉讼等维权费用。建立按国家和类别划分的商标获取与维护成本数据库，明确常规预算与维权专项预算。

（3）地理标志数据

申报与运营投入分析：分析地理标志从申报筹备、官方申报到获权后建立管理体系、品质监控、品牌推广所需的各类投入及成功案例的投入产出比。量化地理标志从申报到后续运营的财务需求，明确各阶段资金投入的重点。

（4）集成电路布图设计数据

登记成本与保护策略分析：分析在不同国家/地区进行布图设计登记的费用构成、时间成本，以及为应对潜在侵权而进行证据固化、司法鉴定、诉讼维权的预估成本。评估不同保护策略的成本差异。

设计成果价值与风险对冲分析：分析同类高价值布图设计在授权许可、转让交易中的价格标杆，以及涉及布图设计侵权的判赔金额与诉讼费用。评估本企业核心布图设计可能产生的直接收入及其在遭遇侵权时可主张的赔偿价值范围。

（三）信息资源

1. 利用目的

通过对知识产权数据资源进行获取、加工和维护，实现内外部知识产权数据高效流转与精准分析，为运行、绩效评价等过程提供数据支撑。

2. 利用方式

（1）数据获取

知识产权数据获取途径见本指引第三章。

（2）数据加工

① 专利数据

对获取的专利数据进行分类标引、同族专利整合、技术功效矩阵构建、侵权风险筛查，形成专利信息报告。报告包含分类清单、同族专利表、技术功效矩阵、高风险专利清单等，并提供数

据利用建议，如研发部门参考技术功效矩阵挖掘创新点，法务部门基于高风险专利清单开展规避设计，知识产权管理机构借助分类清单制定布局策略等。

②商标数据

开展商标近似查询与比对、类别布局分析、品牌关联度梳理、侵权线索筛选等，形成商标风险评估报告。报告包含近似商标清单、类别布局缺口表、品牌关联度分析、侵权线索台账等内容，并提供数据利用建议，如市场部门参考类别布局缺口表补充注册，法务部门基于侵权线索台账开展维权，知识产权管理机构利用近似商标清单制定异议策略等。

③地理标志数据

搜集地理标志产品的产地范围、质量特色指标、产品标准以及企业原料采购地、加工厂位置等数据，形成地理标志合规性监控报告。报告包含产地溯源匹配台账、质量指标符合性核查表、合规缺口台账等，并提供数据利用建议，如采购部门参考产地溯源匹配台账严控原料来源合规性，生产部门依据质量指标核查表调整工艺流程，知识产权管理机构利用合规缺口台账制定供应商准入与风控策略等。

④集成电路布图设计数据

对已登记的布图设计进行层次化解析和关键模块的特征提取与标注，并与企业核心布图设计进行相似度比对及原创性特征分析，形成集成电路布图设计风险管理与创新分析报告。报告包

含相似设计清单、原创性特征汇总表、技术演进脉络图、侵权风险/规避设计建议清单等，并提供数据利用建议，如研发部门参考相似设计清单进行差异化设计，知识产权管理机构利用技术演进脉络图规划芯片设计的布局方向及知识产权保护策略等。

（3）数据维护

①专利数据

建立企业专利专题数据库或数据库应用系统，定期更新内外部专利动态。

②商标数据

建立企业内部数据库应用系统，定期更新商标局公告，实时录入商标注册、续展、维权等动态，开展商标品牌监测。

③地理标志数据

建立企业内部数据库应用系统，同步更新地理标志专用标志使用企业名单及市场数据。

④集成电路布图设计数据

建立企业内部数据库应用系统，定期更新外部布图设计登记公告，实时录入布图设计动态。

五、运行

（一）知识产权基础管理

基于策划、支持等过程的分析结果，结合数据监控和分析，保障知识产权从获取、维护、运用到保护各环节规范有序运行。

1. 知识产权获取

（1）利用目的

根据知识产权目标，分类型制定获取计划，确保权利基础稳固、法律状态清晰、无侵权或权属纠纷隐患，并在数量与类型上与战略保持动态匹配。

（2）利用方式

①专利数据

技术趋势与竞争格局分析：分析目标技术领域的全球专利布局全景，涵盖技术发展路线、核心专利分布、主要竞争对手的专利组合强度与覆盖范围，以及技术合作与许可动态。明确技术创新的热点、空白点及可能的技术壁垒，识别需要重点布局或避开的关键技术分支，评估自主研发、技术引进或合作开发等不同获取路径的可行性与必要性。

创新来源与权属风险分析：计划通过委托开发、合作研发或并购获取专利时，分析目标专利或相关技术包的历史法律状态、权属链条、是否存在质押、许可等权利负担以及发明人背景等。评估其权利稳定性、可转让性以及潜在的权属纠纷隐患。

申请质量与稳定性事前分析：在提交专利申请前，开展技术检索与专利性分析，评估拟申请技术的创新高度、与在先技术的区别特征，以及权利要求的合理保护范围。预测专利申请的授权前景及审查意见，评估授权后权利要求的稳定性。

②商标数据

注册可行性与策略分析：分析拟注册或拟收购商标在目标市

场的在先权利障碍、审查实践以及与本企业商标架构、市场扩张路线的匹配度。判断商标注册成功的概率与时间成本，明确需要规避、异议或谈判的在先权利，确定商标注册的核心类别、关联类别及防御性类别的组合策略。

商标获取方式与风险分析：梳理市场上可供转让或许可的商标资源，评估其市场知名度、美誉度、法律状态及与本企业业务的契合度。同时，监测是否有因“连续三年不使用”可能被撤销的商标。识别通过转让、许可或撤销复审等方式获取商标的机会。

③地理标志数据

专用标志申请方式：梳理本企业产品生产范围、质量检测报告、执行标准等基础资料，核查确认自身为地理标志产品保护区域内的合法生产者，产品产自保护公告规定的特定地域、满足公告规定的质量技术要求且符合已发布的地理标志产品标准等条件，符合上述条件的，可向地理标志产品批准公告指定的市场监管机构提出申请。

④集成电路布图设计数据

登记保护策略分析：分析本企业产品线规划、技术迭代周期、市场竞品保护情况，结合布图设计独创性要求和侵权取证难度，评估登记的必要性与紧迫性。形成核心产品的布图设计登记优先级清单，明确需强制登记的设计及以技术秘密保护为主的设计。

权属合法性分析：在登记前，核查芯片设计的全部创作记录，包括设计草图、中间版本、逻辑仿真文件、版图数据等，确保其

为原创或来源于合法授权，并分析设计人员背景以避免职务成果归属争议。

2. 知识产权维护

（1）利用目的

通过状态跟踪、分类维护、侵权监测，确保已获知识产权持续有效、权利状态清晰、价值明确，避免因维护疏漏导致权利失效或价值贬损。

（2）利用方式

① 专利数据

法律状态监控：跟踪专利的法律状态，重点监控年费缴纳期限、审查答复时限等关键节点。分析同族专利在不同国家/地区的状态差异。定位即将进入缴费期或需答复的专利，识别已失效或即将届满的专利，发现同族专利布局中的状态断层或法律风险。

专利分类维护：根据技术重要性、产品关联度、市场覆盖范围、诉讼/许可潜力等维度，对有效专利进行分类。分析各类专利的实施情况、引证情况及维持成本，明确每件专利的维护优先级和资源投入策略。

② 商标数据

法律状态合规与使用监控：跟踪商标的续展期限、提交使用声明的期限，并监控商标是否在商品/服务类别上合规使用。预警所有商标的续展节点，识别存在“连续三年不使用”撤销风险的商标，以及注册范围与实际使用不匹配的商标。

商标价值与市场秩序监控：监测市场中是否存在与自有商标相同或近似的侵权标识，监测域名注册、社交媒体账号、电商平台店铺中的侵权行为，及时发现并记录侵权行为。

③地理标志数据

合规使用与质量标准监控：监控本企业专用标志使用是否严格遵守产品保护要求与标准，核查自身产品来源、生产工艺与质量指标数据；确保所有使用地理标志的产品均符合保护要求与标准，识别违规使用、以次充好或超范围生产的情形。

④集成电路布图设计数据

法律状态与权利基础监控：跟踪布图设计专有权的保护期限，确认权利的有效性。同时，归档保存证明其独创性的全套创作过程文件，掌握每项布图设计专有权的剩余保护期。

产品市场与侵权风险监控：监测市场上新增竞争性芯片产品，通过技术比对分析其是否存在复制或实质性模仿自身受保护布图设计的风险，锁定高风险竞争对手或产品型号。

3. 知识产权运用

（1）利用目的

通过实施和使用、许可和转让、投融资、企业重组等多元化场景，实现知识产权市场价值、战略价值的最大化。

（2）利用方式

①实施和使用

a. 专利数据

实施价值与转化潜力分析：分析专利组合与现有产品线、未来技术路线的对应关系，评估专利的技术成熟度、市场应用前景。同步监测行业内专利的许可、转让交易数据及质押融资案例，跟踪技术合作与联盟动态。识别出具备高转化潜力、可用于内部产品升级或新业务孵化的核心专利，明确可通过许可、转让、作价入股等方式实现商业化的专利资产，发现潜在的技术合作伙伴或联盟机会。

自由实施（FTO）与风险排除分析：实施和使用前，开展 FTO 分析，排查拟实施技术方案可能侵犯的专利，并分析相关专利的法律稳定性与权利人的许可意向。明确产品上市可能面临的侵权风险点、风险等级及潜在的权利人，评估通过技术规避、专利无效或主动许可等方式排除风险的可能性和成本。

b. 商标数据

商标授权管理分析：分析商标的市场知名度、商标延伸潜力，以及在不同商品/服务类别和地域上的商业价值。同时，研究同类产品商标的许可经营模式、加盟体系及商标合作案例。评估商标用于品牌延伸或授权许可的商业可行性与风险，明确最有价值的授权类别、地域及合作模式。

c. 地理标志数据

地理标志合规使用分析：实施前，检索专用标志使用企业、地理标志产品保护要求、商标注册信息等，掌握地理标志产品的产地范围、专用标志使用资质等信息，规划地理标志使用场景，

制定合规使用规范，定期抽查产品包装与宣传材料。

d. 集成电路布图设计数据

成果商业化与风险管控分析：布图设计登记完成后，分析其可实施的商业化路径，包括自主量产、委托代工、对外授权或整体转让等。同时，对潜在的被许可方或合作伙伴进行背景与风险分析，制定针对性的授权或许可协议框架，明确授权范围、地域、期限及收益分配机制，并识别合作中的技术泄漏或违约风险。

② 许可和转让

a. 专利数据

权利稳定性与法律风险分析：许可或转让前，对目标专利进行稳定性分析，排查是否存在未决诉讼、质押、独占许可等权利负担。核查发明人背景以确认权属清晰无争议，并出具关于专利权利稳定性及法律风险的专业评估报告。

市场价值与许可机会分析：分析特定技术领域内专利的交易历史数据，包括许可费率范围、转让价格、专利池的许可模式，以及行业内活跃的被许可方和许可方。同时，结合自身专利的技术先进性、市场覆盖范围等，评估自身专利组合在许可市场中的价值定位和合理定价区间，识别潜在的技术需求方，并确定适合的许可模式。

b. 商标数据

使用合规与风险防控分析：许可前，核查被许可方的资质、生产能力、质量控制体系及营销渠道，确保其有能力维持商标。

转让前，核查商标是否存在“连续三年不使用”等撤销风险，以及许可合同是否已妥善备案或解除。确认商标权属清晰、无影响交易的权利负担或隐患。

市场价值与许可机会分析：分析特定行业及核心商品/服务类别内商标的交易历史数据，包括许可费率区间、转让成交价格、头部品牌的许可运作模式等。同时，结合本企业商标的品牌知名度与美誉度、核定使用范围与防御布局、市场使用效益、权利稳定性与合规性等维度，评估本企业商标的价值定位区间，识别潜在的商标需求方，并确定适合自身发展战略的许可模式。

c. 集成电路布图设计数据

权属状态分析：许可或转让前，复核布图设计登记证书的有效性。同时，设计严密的许可合同，明确授权范围、授权地域、工艺限制及保密义务。确保布图设计权属稳定、法律状态清晰。

技术先进性评估：分析布图设计的核心技术节点、性能优势、应用领域的市场规模及增长趋势。评估该布图设计作为可许可 IP 核的市场竞争力和商业潜力，确定其在 IP 组合中的定位，并预测潜在的被许可方群体。

③投融资

a. 专利数据

投资风险分析：通过专利检索，获取拟投资企业的专利数量及清单、有效性、法律状态、专利权权属等信息。结合拟投资企业专利的被引用次数、实施转化率、技术分支分布，评估其核心

技术的行业影响力与市场应用前景，分析标的产品技术特征与他人专利的重合度，判断其侵犯第三方专利的潜在风险，核查拟投资企业历史专利纠纷记录及未了案件，评估投资风险。

质押融资可行性分析：分析拟用于质押融资的专利包的权利稳定性、侵权诉讼风险、技术迭代风险以及市场变现能力，明确其作为质押物的核心优势与潜在瑕疵，预估其质押率区间。

b. 商标数据

价值识别与风险定价：分析拟投资企业的商标体系，包括主品牌与子品牌的架构关系、商标法律状态、使用合规性、市场认知度以及是否存在未决的异议、无效或侵权诉讼。评估拟投资企业商标资产的实际价值和潜在风险，识别可能因法律瑕疵而需要调减交易对价或设置赔偿条款的风险点。

c. 地理标志数据

投资风险分析：通过地理标志检索，获取投资涉及地理标志相关信息，查询地理标志专用标志使用企业资质、企业违规记录以及产品的检测报告合格率，评估合规风险。

d. 集成电路布图设计数据

技术估值分析：分析拟投资企业的核心布图设计登记情况、技术独创性、与市场主流架构的兼容性/先进性以及设计团队的技术背景。评估该布图设计所代表的技术突破和产品化潜力，判断其是否构成公司的核心竞争壁垒。

风险分析：逐一核查拟投资企业声明的核心布图设计的登记

证书、创作记录、权属证明（特别是涉及委托开发或合作开发的部分）。确认拟投资企业核心知识产权的真实性与完整性，评估因权属瑕疵可能引发的整合风险与价值损耗。

④企业重组

a. 专利数据

专利价值评估分析：企业分立、重组或业务线出售前，对涉及的专利资产进行全面盘点、分类和评估。分析内容包括：专利与具体业务/产品线的关联度、法律状态的稳定性、剩余保护期限、市场公允价值以及维持成本。明确哪些是必须随核心业务转移的关键专利，哪些是可剥离的非核心资产，哪些是应放弃的低价值或高维护成本专利。

权属梳理与风险诊断：深度核查专利的原始申请人和发明人信息，排查是否存在职务发明权属争议、合作开发或委托开发协议未明确权属，以及专利质押、独占许可等权利限制。识别专利资产中存在的权属不清、权利负担或潜在纠纷风险点。

b. 商标数据

商标与业务关联分析：分析本企业所有商标与各业务板块、产品线、子公司及销售地域的对应关系和使用历史，评估主商标、子商标及防御性商标在重组后新架构下的必要性与布局合理性。厘清商标资产与业务运营的关联，判断在分立、重组后，哪些商标应随业务转移，哪些可由原主体保留，并识别出因业务拆分可能产生的商标共存或冲突问题。

法律状态分析：核查待重组业务所涉及商标的注册状态、使用证据完备性以及是否存在未决的异议、无效宣告或侵权诉讼。评估商标资产的法律状态，预警因重组过程中的管理交接疏忽或历史问题可能导致的权利失效风险。

c. 地理标志数据

业务关联分析：企业分立、重组或业务线出售时，对地理标志资产（包括地理标志产品、地理标志商标、专用标志使用权等）进行全面梳理。分析地理标志与核心业务、主营产品线、生产基地及原料供应地域的绑定深度。明确哪些地理标志必须随特定业务转移，哪些可保留在原主体，并识别重组后可能出现的产地重叠、标志共用等冲突风险。

d. 集成电路布图设计数据

权属核查：在芯片设计部门或公司重组时，分析所有布图设计登记与特定项目、产品团队及技术路线的对应关系，核查每项登记的创作记录和权属文件，避免资产归属模糊或遗漏。

风险排查：排查待转移的布图设计是否存在权属争议、是否依赖于第三方许可的技术以及相关的许可协议是否允许在重组情况下的权利转让或继承等，识别布图设计资产转移可能面临的法律障碍和合规要求，形成风险清单与解决方案建议。

4. 知识产权保护

（1）利用目的

聚焦风险管理与争议处理两大保护场景，通过知识产权风险

监测、侵权应对等措施，防范侵权风险、高效处置纠纷。

（2）利用方式

①风险管理

a. 专利数据

侵权风险预警与竞争监控分析：产品研发或上市前，检索并分析目标市场的在先专利，关注权利要求范围宽泛、法律状态稳定且权利人诉讼倾向明显的专利。同时，持续监控主要竞争对手的专利申请动态与诉讼活动，识别产品实施可能侵犯的具体专利及风险等级。

b. 商标数据

法律状态与合规使用监控分析：监控本企业所有注册商标的续展期限，并核查商标在核准商品/服务上的实际使用情况。重点排查是否存在“连续三年不使用”被撤销的风险，以及注册信息变更后是否及时办理备案。

商标侵权与风险监测分析：在市场及主要注册渠道中，持续监测是否存在与自有商标相同或近似的标识被注册或使用。同时，监测商标是否被泛化使用。及时发现抢注、仿冒等侵权行为以及商标被淡化的迹象，评估其对本企业商标独占性和市场声誉造成的现实与潜在损害。

c. 集成电路布图设计数据

侵权风险排查：芯片设计阶段与流片前，对目标设计进行相似性检索与分析，排查是否存在复制或实质性模仿他人已登记布

图设计的风险，评估侵权风险等级并采取相应措施。

② 争议处理

a. 专利数据

被指控侵权时的应对：检索被诉专利的法律状态是否已过保护期、是否存在权利瑕疵。通过专利数据平台查找被诉专利的现有技术文献，如申请日前公开的专利、论文，同族专利信息，若现有技术已公开被诉专利的核心技术特征，可向国家知识产权局专利复审和无效审理部提出专利无效宣告请求；同时，提交自身产品不侵权的技术比对报告，进行不侵权抗辩。

维权诉讼与投诉处置：以固定的侵权证据为基础，向市场监管部门投诉或向法院提起诉讼，要求侵权方停止侵权、赔偿损失。在诉讼过程中，利用专利数据平台提供的专利有效性证明、侵权比对分析报告，强化诉讼主张。

b. 商标数据

被指控侵权时的应对：检索被诉商标的法律状态是否在保护期内、是否存在权利瑕疵。若对方商标是通用名称、缺乏显著性或以欺骗手段取得注册或其连续三年未使用，可向国家知识产权局主张商标无效或申请撤销。同时，对比双方商标标识的读音、字形、含义、整体结构，以及商品/服务的类似程度，证明不构成混淆性近似，进行不侵权抗辩。

维权诉讼与投诉处置：以固定的侵权证据为基础，向市场监管部门投诉或向法院提起诉讼，要求侵权方停止侵权、赔偿损失；

在诉讼过程中，利用商标数据平台提供的商标有效性证明、侵权比对分析报告，强化诉讼主张。

c. 地理标志数据

维权诉讼与投诉处置：涉及地理标志侵权纠纷时，调取地理标志认定公告、专用标志使用企业等数据，证明其他企业侵权使用地理标志专用标志的违规事实，并向监管部门举报查处。

d. 集成电路布图设计数据

被指控侵权时的应对：核查涉案布图设计的登记信息、授权范围，分析本企业布图设计的原创性，明确与涉案设计的差异点，收集研发记录、设计过程文件、技术比对报告并委托专业机构出具原创性鉴定意见作为证据。以布图设计具有原创性，不构成侵权为核心理由，提交研发记录与技术比对证据进行抗辩或委托布律所代理诉讼。

维权诉讼与投诉处置：以固定的侵权证据为基础，向市场监管部门投诉或向法院提起诉讼，要求侵权方停止侵权、赔偿损失。

（二）知识产权经营管理

基于策划、支持等过程的分析结果，将知识产权数据深度嵌入立项、研发、采购等业务流程，实现知识产权与业务的融合。

1. 立项

（1）利用目的

项目启动前，对数据进行检索与分析，识别竞争对手/合作伙伴、评估风险，为研发、设计、创作等过程提供依据。

（2）利用方式

①知识产权信息分析与竞争对手/合作伙伴识别

a. 专利数据

技术路线分析：检索项目涉及技术领域的专利，分析申请趋势、申请人、主要技术构成等数据，判断项目技术方向的创新空间与竞争热度，帮助企业决定项目是否立项，或调整技术路线以规避高风险区域，明确后续项目研发中的跟踪与风险监控重点。

技术合作网络分析：分析目标技术领域内专利申请人的合作申请网络、专利相互引证关系等情况，以及高校/科研院所的专利转让或许可对象。明确该领域的核心创新集群、产学研合作紧密的团队以及技术流动的主要方向，识别出在技术上互补、具有共同研发历史的潜在合作伙伴。

竞争态势分析：分析主要市场竞争者的专利布局密度、核心专利包、专利诉讼历史以及专利异议/无效宣告活动，评估各竞争者的专利实力与攻击性/防御性策略，识别出专利壁垒高的市场领导者、积极运用专利诉讼进行市场排他的“激进型”竞争者，以及专利实力薄弱、可能面临被诉风险或成为收购目标的“脆弱型”对象。

b. 商标数据

市场进入分析：分析目标行业/商品类别中商标的申请量、集中度、主要品牌持有者的商标家族构成、商标延伸轨迹，以及新进入者的申请动态。识别占据主导地位的商标、正积极进行品

类扩张的竞争对手，以及新兴品牌的活跃领域，发现市场竞争的“红海”与“蓝海”区域。

c. 集成电路布图设计数据

技术路线分析：分析在目标领域频繁进行布图设计登记的企业，梳理其设计的技术演进路径，并关注设计服务公司的客户群体，摸清该领域的技术主导者、专业的设计服务公司，识别在细分赛道具有独特设计能力的中小型设计公司。

知识产权保护策略分析：分析目标领域企业的布图设计登记策略、是否发起或应对过相关侵权诉讼，以及专利与布图设计组合上的协同布局情况。判断各企业对布图设计保护的重视程度及其进攻性或防御性保护策略的侧重。识别知识产权组合管理成熟、可能通过许可进行合作的对象，以及可能对侵权行为持强硬态度的对象。

② 知识产权风险评估

a. 专利数据

自由实施（FTO）与侵权风险评估：项目技术方案初步确定后，针对拟采用的技术路径，检索并分析目标市场内的相关专利，重点关注保护范围宽泛、法律状态稳定的核心专利及其权利人过往的诉讼历史。识别项目技术方案可能面临的侵权风险，评估侵权的可能性与潜在后果的严重性，并初步锁定可能提起侵权诉讼的对象。

b. 商标数据

注册成功性与权利获取风险评估：根据项目拟推出的产品或服务名称，分析其在目标市场、相关商品/服务类别上的在先商标注册情况，研究当地审查实践与消费者认知习惯。预测项目品牌成功注册为商标的法律风险概率，识别主要的在先权利障碍及潜在异议方，并判断是否存在被认定为“缺乏显著性”或“具有不良影响”等驳回理由。

竞争态势评估：分析目标市场内相关行业主要品牌的商标布局策略、历史争议案例以及消费者对近似品牌的识别度。评估项目品牌进入市场后，与现有品牌发生市场混淆与法律冲突的可能性，了解行业的品牌竞争程度。

c. 地理标志数据

原料/产品使用合规评估：分析项目计划使用的核心原料、加工工艺或最终产品，是否与已受保护的地理标志相关联，或是否位于其特定产区内。明确项目在原料采购、生产加工或产品命名上，是否会因触及地理标志的保护要求而面临违规使用产地名称或特定工艺的法律风险。

d. 集成电路布图设计数据

自由实施（FTO）的预评估：项目立项时，对拟采用的架构方案、关键电路模块进行初步检索，分析是否存在可能构成实质性相似的已登记布图设计。预警项目在起步阶段就可能面临的底层设计侵权风险，识别高风险技术模块。

技术来源与风险评估：分析项目计划采用的设计方法、IP

核来源，核查拟使用的第三方 IP 的权利链条是否清晰、许可范围是否覆盖项目目标。评估项目核心技术的自主可控程度，识别对外部 IP 的依赖风险以及因使用开源或不明来源设计可能带来的风险。

2. 研发、设计、创作

（1）利用目的

通过开展知识产权数据检索与风险评估、布局规划与成果保护、定期监控与策略调整，保障创新成果合法可控，规避侵权风险，优化创新方向与保护策略。

（2）利用方式

① 知识产权数据检索与风险评估

a. 专利数据

技术方案新颖性与可专利性的评估：形成具体技术方案后、正式提交专利申请前，进行专利性检索，分析全球范围内最接近的现有技术，评估拟申请技术的新颖性、创造性。判断技术方案获得专利授权的可能性，明确其相对于现有技术的创新高度，识别专利申请文件中需要重点阐述的发明点与区别特征。

侵权风险监控与分析：在研发过程中，针对技术方案的具体实现细节、实验数据及迭代版本，持续进行专利检索与比对分析。重点关注与研发路径高度相关的核心专利的权利要求变化、法律状态更新，以及主要竞争对手新公开的专利申请，识别研发过程中新出现的、具体的侵权风险点，预警因技术路线微调或竞争对

手新布局而产生的潜在壁垒。同时，评估自身创新点与现有技术的区别特征，为后续专利申请挖掘亮点。

b. 商标数据

商标设计可行性分析：在产品研发与市场策划同步进行时，针对设计中的产品名称、LOGO 等商标元素，在目标市场进行商标检索，排查是否有在先相同或近似商标，并评估其显著性。在商标定型前，识别其作为商标注册和使用的法律风险，提供修改或规避建议。

c. 地理标志数据

生产工艺与品质特征符合性评估：在研发或改进涉及特定产地的产品的配方、工艺时，检索地理标志的相关公告，比对拟采用的原料来源、加工方法、质量指标是否符合其保护要求。判断产品研发方向是否与地理标志保护要求相冲突，或是否具备通过合规化改进后，申请使用地理标志的潜力。

d. 集成电路布图设计数据

模块设计阶段的侵权风险排查：在芯片各功能模块设计过程中，针对具体电路设计图，分阶段、分模块进行相似性检索与分析。在设计的前期和中期，及时发现特定模块可能存在的侵权风险，调整规避或优化方向。

② 知识产权布局规划与成果保护

a. 专利数据

研发路径与创新成果布局分析：在研发过程中，持续跟踪技

术方案的演进，并与专利数据库中的现有技术及自身已申请专利进行比对，分析每一个技术改进点、实验突破及技术问题的创新解决方案，识别具备可专利性的技术创新点，结合其重要性、关联性进行分类和优先级排序。同时，发现可能因公开而丧失新颖性的风险点。

规避设计分析：分析主要竞争对手的专利布局，识别其核心专利的保护范围边界及潜在的漏洞，寻找可进行规避设计以绕过竞争对手专利的技术路径。

b. 商标数据

产品概念与商标同步保护规划：在产品的工业设计、功能定义及市场定位阶段，在多个目标市场进行商标可注册性预检索，同步分析拟使用的产品系列名称、核心功能命名、外观设计理念以及广告口号。在产品定型前，确定一套法律风险低、可注册性高的商标方案，并规划其注册的时间表和类别策略。

c. 地理标志数据

产品升级规划：若研发聚焦地理标志产品质量升级（如改进特定产品加工工艺等），可检索地理标志产品认定公告，评估新质量指标是否符合产品保护要求，避免地理标志资格失效。

d. 集成电路布图设计数据

布局分析：在架构设计和模块划分阶段，分析各功能模块的独立性、复用价值以及可能的对外授权潜力，评估整体与关键模块分别进行布图设计登记的可行性，明确哪些模块独立保护更有

利于未来的技术许可或合作，如何划分以最大化保护范围。

③知识产权定期监控与策略调整

a. 专利数据

技术动态与竞争情报监控分析：定期检索与项目技术领域相关的最新专利申请与授权公告，追踪主要竞争对手、科研机构及行业新进入者的研发动态。同时，监控关键专利的法律状态变化及相关的诉讼、异议案件。及时掌握技术发展趋势的变化，预警新兴的技术路线和潜在的专利壁垒，了解竞争对手的研发重点、合作网络及专利保护策略等。

b. 商标数据

商标使用环境与法律状态监控分析：定期监测项目产品/服务名称、标识在实际使用中的市场反馈，以及商标公告中出现的可能与自有商标构成冲突的新商标申请，预警新出现的注册障碍与潜在冲突方。同时，跟踪自有商标的审查、异议、续展等法律流程状态，确保法律流程按期推进，无管理疏漏。

c. 地理标志数据

地理标志合规与市场动态监控分析：定期监测地理标志相关政策法规、产地资源环境及行业监管要求的最新变化，核查本企业及供应商地理标志使用的合规性，包括专用标志标注规范、产地溯源完整性、品质达标情况等。同时，跟踪市场上地理标志相关产品的使用动态，检索可能存在的侵权仿冒行为、虚假产地宣传等问题，及时预警潜在的合规风险与品牌侵权隐患。

d. 集成电路布图设计数据

风险监控：每一个设计版本完成后，针对性开展布图设计FTO检索与比对分析。同时，持续关注行业内新公开的、与自身设计领域相关的布图设计登记信息，了解同期内竞争对手或同行在相似设计上的进展与保护情况，确保没有引入新的侵权风险。

3. 采购

（1）利用目的

利用知识产权数据进行拟采购物核查、供应商筛选，从源头确保拟采购物所涉及的知识产权合法合规，来源清晰、权属明确，无侵权隐患。

（2）利用方式

①拟采购物核查

a. 专利数据

拟采购物权属与转移情况识别：采购涉及技术转让或许可时，深入调查该技术相关专利的法律状态、权属历史、是否存在共同权利人或未决诉讼，以及许可链条是否完整、清晰。识别其中潜在的权利负担、权属争议点以及许可范围限制。

拟采购物的风险筛查：对拟采购的产品、设备或技术模块，进行深入的专利检索与分析。重点排查其制造、使用、销售及后续的改进是否会落入第三方有效专利的保护范围，尤其是目标市场所在地的专利。明确拟采购物是否可能构成侵权产品，评估其引入后为本企业带来的侵权风险等级，并锁定风险专利及权利人。

b. 商标数据

拟采购产品的商标法律状态核查：核查拟采购产品上附带的商标是否由供应商合法持有或已获得充分授权。检索该商标在目标市场的注册情况、法律状态及是否存在争议，判断产品使用相关商标是否合法，识别采购方因销售/使用带有该商标的产品而面临的商标侵权与假冒风险。

拟采购软件/技术方案中商标的核查：核查拟采购的软件、技术文档或解决方案是否未经授权使用了第三方的商标，并核查其使用方式是否符合相关许可协议，识别软件或技术方案中潜在的商标违规使用风险。

c. 地理标志数据

拟采购物真实性核查：当采购特定产地的原料或初级加工品时，核实产地真实性，并检查其产品包装上地理标志专用标志使用的合规性，判断采购产品是否为地理标志产品。

d. 集成电路布图设计数据

拟采购物的来源核查：采购芯片或核心模组时，要求供应商披露其中所含集成电路布图设计专有权来源，区分供应商自研、第三方授权或不明渠道等途径。核查关键芯片是否已进行布图设计登记。识别是否存在侵权风险，以及供应商是否具备合法的处置权。

② 供应商筛选

a. 专利数据

供应商技术实力与创新能力评估：分析潜在供应商的专利数量、技术领域分布、专利质量以及专利申请趋势。同时，关注其专利的诉讼事件。评估该供应商技术领先地位、研发活跃度和持续性，以及运用专利保护自身技术的意识和能力，以此判断其是技术领导者、跟随者或是模仿者。

供应商产品/技术侵权风险分析：针对供应商拟提供的核心产品或技术，进行初步的专利侵权风险筛查，分析其是否侵权。同时，核查供应商是否为其产品/技术所涉及专利的合法权利人或被许可人。评估从该供应商处采购特定产品或技术可能带来的侵权风险等级。

b. 商标数据

供应商商标合规性与授权资质核查：核查供应商拟销售产品所附商标的注册情况、法律状态及权属证明。若供应商销售的是代理或贴牌产品，需核实其是否持有有效的品牌授权书，且授权范围是否覆盖本次采购。判断供应商是否有权在其销售的产品上使用相关商标，其经营行为是否具备合法的商标权。

c. 地理标志数据

供应商产地资质核查：当采购涉及地理标志产品时，严格核验供应商是否位于该地理标志产品保护的产地范围内，是否已被核准使用地理标志专用标志，确认该供应商是否为地理标志产品的合法提供者，其所售产品是否为受保护产品。

d. 集成电路布图设计数据

供应商产品知识产权来源核查分析：采购芯片等相关产品时，要求供应商披露其产品的集成电路布图设计专有权来源，并可要求其提供核心芯片的布图设计登记证书作为佐证。评估供应商所提供芯片产品的知识产权清晰度和法律风险等级。

4. 生产和服务提供

（1）利用目的

聚焦生产与服务提供过程中的技术创新、风险管控，确保产品合法入市、明确技术合作权益，保障生产经营合规高效。

（2）利用方式

① 技术改进与创新

a. 专利数据

规避设计、工艺优化与成本降低分析：针对生产环节中遇到的技术瓶颈、效率低下或成本高昂的问题，开展专利检索，分析现有技术中解决同类问题的不同技术方案、工艺路径及设备改进方向，识别可借鉴或启发的现有技术方案，明确不同技术路线的优缺点、实施成本及潜在的侵权风险，以及识别已有专利布局中的空白点或改进点。

供应链协同与技术合作机会发现：分析主要设备供应商、原材料供应商或技术服务商的专利布局，了解其在相关领域的技术专长与最新成果。同时，关注产业链上下游企业的共性技术难题及其专利解决方案。发现供应商潜在的技术增值能力，识别通过供应商早期参与或联合研发来解决生产难题的机会，明确产业链

上可进行技术协作或知识共享的节点。

b. 商标数据

商标延伸与布局机会发现：分析核心商标在相关服务领域的注册覆盖情况，以及消费者对商标延伸至新服务领域的认知与接受度。监测市场中新服务领域的商标注册动态。评估依托现有商标开拓新的服务产品线或商业模式的可行性，预警新服务领域商标名称的注册风险，发现商标布局机会。

c. 地理标志数据

品质提升与工艺创新分析：若技术改进涉及地理标志产品，例如对产地原料加工工艺进行优化，则需获取该地理标志产品质量特色指标中的相关工艺参数与成分要求，评估改进后的工艺是否仍符合地理标志产品保护要求。

d. 集成电路布图设计数据

设计优化与性能提升分析：针对性能瓶颈、功耗过高、集成度不足、兼容性差等问题，开展检索与分析，梳理现有布图设计的电路架构、模块布局、布线方式等技术方案，识别可借鉴的设计思路与优化方向。明确不同设计方案的性能优势、实施成本、工艺适配性及潜在侵权风险，同时识别现有布图设计布局中的空白点与创新点，以满足产品升级需求。

② 侵权风险管控

a. 专利数据

生产设备与工艺路线监控：选定生产设备和确定工艺路线后，

定期监控与设备核心功能、特有工艺参数或优化方法相关的专利动态，重点关注竞争对手、设备商及行业新进入者可能获得的、保护范围覆盖现有生产实践的新授权专利，锁定风险专利及权利人，评估风险等级。

b. 商标数据

商标使用风险监控：在产品组装、包装环节及服务资料制作过程中，核查所有即将附着于产品实体、包装物、说明书及服务手册上的商标是否均获得合法授权或为自有权利。重点排查图形用户界面、广告语等，确保出厂产品或提供的服务所附带的所有商标均清晰、合法。

c. 地理标志数据

原料入库与生产投料核查：生产投料前，核对采购的声称源于特定地理标志产区的原料，是否随附有效的产地证明、授权文件及质量检测报告。核查原料的品种、质量指标是否符合地理标志的要求。

d. 集成电路布图设计数据

侵权风险分析：在芯片量产阶段，分析工艺设计套件、标准单元库等是否来自合法授权。同时，核查测试方案、测试向量是否可能涉及对第三方布图设计专有权的反向工程或超出合理范围的分析。确认芯片制造与测试外包服务不引入新的侵权风险，明确与代工厂、测试厂之间的责任划分。

5. 销售和售后

（1）利用目的

利用知识产权数据防范市场推广与销售环节的侵权风险，及时发现并处置侵权行为，动态优化知识产权保护策略，保障产品升级与市场拓展有序推进。

（2）利用方式

①产品/服务对外宣传、参展、销售前的知识产权风险核查

a. 专利数据

表述核查：对产品手册、官网技术参数、广告视频、展会演示文稿等所有对外宣传材料中，涉及产品功能、技术原理、性能指标、实现方法的描述性内容，进行专利检索与分析。重点核查这些描述是否精准对应自有专利的保护范围，是否可能落入他人专利的权利要求范围，识别宣传中对自身技术的过度披露以及对他人技术可能构成许诺销售侵权或虚假宣传。明确在特定销售地域，宣传中突出的技术卖点是否存在专利侵权风险。

自由实施（FTO）分析：产品正式销售前，结合最终确定的产品技术状态、目标市场及商业模式，进行FTO分析。对产品为目标市场制造、使用、销售、许诺销售、进口等各个环节的专利侵权风险做出最终评估，锁定研发、生产阶段未发现或新出现的风险专利。

b. 商标数据

风险核查：核查所有宣传材料（如广告语、宣传口号、社交媒体话题标签、产品别称以及官网、广告的视觉设计元素等）是

否与他人注册商标构成混淆性近似。同时，检查计划使用的推广域名、社交媒体账号名称是否存在商标冲突。识别宣传推广活动中潜在的商标侵权与不正当竞争风险点。

c. 地理标志数据

地理标志合规核查：若本企业产品为地理标志产品，上市前比对产品检测报告与地理标志产品保护要求，核查产品质量和专用标志使用是否合规。

地理标志市场分析：若本企业产品非地理标志产品，在进入区域特色产品市场时，通过地理标志数据查询该市场的地理标志产品类型、保护范围及市场占有率等，判断本企业产品是否可对接当地地理标志资源，或避开已有地理标志的同质化竞争。

d. 集成电路布图设计数据

产品公开披露与技术讲解内容核查：在产品发布会、技术研讨会、销售培训等场合，计划公开披露的芯片内部结构图、性能框图、关键技术指标等，核查这些披露是否可能泄露受保护的布图设计核心细节，或是否在描述中涉及了对他人专有设计的复制。

②产品销售市场的知识产权侵权监控

a. 专利数据

侵权比对分析：监控销售市场中新出现的竞品，通过产品拆解、技术分析、公开参数及宣传资料，识别其采用的技术方案与核心功能。将这些技术特征与本企业已获授权的核心专利的权利要求范围进行逐一比对分析，初步判断竞品是否侵犯自身专利权，

锁定具体的侵权产品和厂商，评估侵权行为对本企业市场份额、价格体系等造成的损害程度。

b. 商标数据

侵权识别分析：监控线上、线下销售渠道，包括电商平台、社交媒体、实体店铺等，检索与本企业商标相同或高度近似的标识所对应的在售商品或服务。实时发现并记录商标侵权行为，包括侵权主体、侵权规模、发生地域以及具体的侵权形式。

c. 地理标志数据

侵权监测分析：监控线上、线下销售渠道（包括电商平台、实体店铺、批发市场等），检索与本企业地理标志名称相同或近似的产品宣传及包装标识。通过产品抽样购买、溯源信息核实、质量指标检测等方式，验证产品是否符合地理标志保护要求。初步判断是否构成地理标志侵权，明确侵权主体、发生地域及具体形式等，评估侵权行为对地理标志声誉、品牌价值及市场秩序造成的损害程度。

d. 集成电路布图设计数据

相似比对分析：针对市场上疑似侵权的竞品，在合法合规的前提下，通过反向工程获取其布图设计信息，与本企业已登记的布图设计进行专业、细致的比对分析。从技术层面获得竞品与本企业产品构成实质性相似的证据。

③产品/服务升级或市场环境变化后的知识产权策略调整

a. 专利数据

技术特征与市场环境变化分析：针对产品/服务升级引入的新功能、新算法、新工艺或新材料，分析其在新技术领域的专利布局现状、主要权利人与竞争格局。同时，关注市场环境变化，分析这些变化带来的新的专利风险与机会区域。明确升级部分的技术创新高度与可专利性，识别相关领域的潜在合作伙伴、主要竞争对手，评估原有核心专利在新市场环境下的保护强度是否足够，以及是否存在被新出现技术替代的风险。

自由实施（FTO）的重新评估与应对：针对升级后的整体产品/服务方案，结合其计划进入的新市场，开展全面的 FTO 分析。重点关注升级部分是否引入了新的侵权风险。量化升级产品或进入新市场后的侵权风险变化，锁定新增的风险专利及权利人。

b. 商标数据

商标延伸与市场拓展需求分析：产品/服务升级后，分析现有核心品牌在新业务领域的认知度、注册覆盖情况，以及计划进入的新市场中，品牌名称或标识是否存在在先权利冲突或文化障碍。评估升级后品牌选择路径，确定延续原品牌或启用新品牌。

c. 地理标志数据

产品品质升级的再评估：若产品/服务升级涉及对地理标志产品的品质提升、工艺改进或功能拓展，需详细分析这些升级是否符合地理标志保护要求。判断升级后的产品是否还能使用原地理标志。

d. 集成电路布图设计数据

持续保护策略分析：针对产品的迭代升级，分析升级部分布图设计的独创性，评估其对整体产品性能的贡献度，以及是否适合作为新的布图设计进行单独或组合登记。明确需要为升级部分申请新的布图设计保护的具体内容。

风险与许可模式调整：产品从原有应用市场拓展至新市场时，分析新市场对芯片可靠性、安全标准的要求，以及该领域竞争对手的专利与布图设计布局特点。评估进入新市场后，布图设计面临的侵权风险变化。

6. 合同管理

（1）利用目的

基于知识产权数据设计各类对外合同的知识产权条款，保障合同全流程知识产权管理合法合规、权责清晰。

（2）利用方式

① 知识产权对外委托业务合同

a. 专利数据

留存委托检索、分析过程中形成的对比文件、专利法律状态报告、风险等级评估表及侵权预警分析数据。将上述材料作为合同知识产权归属条款的核心附件，明确约定委托成果的知识产权归属及后续使用权限。

b. 商标数据

留存委托商标监测、近似查询过程中形成的近似商标监测报告、异议或无效案件相关材料及商标布局分析数据。在合同中明

确约定上述监测及分析结果的归属，同时界定委托方对相关数据的使用范围及保密要求。

c. 地理标志数据

留存委托开展的地理标志溯源核查报告、专用标志使用合规检测记录、侵权排查数据及产地范围校验材料。在合同中明确此类数据的归属，约定受托方的保密义务及数据使用限制。

d. 集成电路布图设计数据

留存委托侵权排查、布图设计图形比对报告、芯片拆解检测记录及技术特征分析数据。明确约定排查结果、检测数据及分析报告的归属，同时补充约定数据的保密期限及受托方对核心技术数据的保密责任。

②委托开发或合作开发合同

a. 专利数据

权属界定：合同谈判前，检索并分析合作各方在合同涉及技术领域已拥有的专利，并基于项目研发目标，预判可能产生新专利的技术方向，分析各方的技术贡献预期及不可替代性，明确各方技术实力的对比与合作依赖关系。

侵权风险分析：分析合作项目拟采用的初始技术方案是否存在侵犯第三方专利权的风险，识别合作项目本身可能面临的初始侵权风险，并评估合作方是否有专利许可权。

b. 商标数据

商标可注册性分析：若合作涉及共同推广、使用现有商标或

需要创建新的商标，需先分析各方商标的知名度、注册情况，并对拟申请商标的可注册性进行检索。确定各方商标资源的可利用范围，评估新商标的法律风险与合作价值。

c. 地理标志数据

品质一致性预判：若合作涉及地理标志产品的工艺改良，需检索并分析现有地理标志产品的质量特色指标、产地环境要求及生产技术规范，预判合作开发方案对地理标志核心品质特征可能产生的影响。分析各方在原料产地、传统工艺传承等方面的优势与不可替代性，评估合作成果是否符合地理标志保护要求。

d. 集成电路布图设计数据

创作溯源与权属边界界定：检索布图设计登记信息，对合作各方已有的布图设计资产进行盘点，预判合作项目中可能产生的独创性布图设计节点。通过现有设计与拟开发设计的相似性比对，分析各方技术贡献的不可替代性，明确背景知识产权与前景知识产权的划分边界。

③外部供方合同

a. 专利数据

自由实施（FTO）分析：签约前，对供应商拟提供的核心产品、关键部件或技术方案进行专利侵权风险检索，重点关注是否可能侵犯第三方专利权。同时，核查供应商是否为其所提供技术的合法权利人或已获得授权的被许可人。

b. 商标数据

商标授权范围分析：当供应商提供的产品或服务将带有采购方商标时，分析该商标包括使用的商品/服务类别是否完全覆盖合同标的。确定商标授权使用的具体法律边界与质量保障要求。

c. 地理标志数据

合规条款分析：通过地理标志专用标志核准公告检索，获取供应商地理标志使用资质数据，约定地理标志合规承诺等条款。

d. 集成电路布图设计数据

授权范围分析：检索集成电路布图设计公告，查询许可范围、权利期限等供应商布图设计专有权数据，约定布图设计使用权限。

④ 对外协作合同

a. 专利数据

权责界定分析：合同起草前，检索并分析协作各方在合作领域内的现有专利布局，评估各方技术贡献的独特性和依赖性。同时，基于协作目标，预判协作过程中可能共同或分别研发的新技术方案及其可专利性。评估各方在协作中的技术地位与议价能力，并识别未来可能形成的共有或单独所有的专利资产。

风险分析：对协作拟采用的核心技术路线开展专利侵权风险评估，识别可能涉及的第三方专利壁垒。同时，核查各方相关专利权属状态，且具备对外许可权。量化协作项目初始面临的外部侵权风险，并评估各方内部专利资产的稳定性。

b. 商标数据

商标整合策略分析：当协作涉及共同市场推广、商标联合或

创建新商标时，分析各方自有商标的声誉、注册覆盖范围及与协作内容的关联度。对拟共同使用的商标进行可注册性检索。评估各方商标的协作价值与潜在冲突，明确联合商标使用的法律风险与商业潜力，确定商标整合的最佳策略。

c. 地理标志数据

合规条款分析：通过地理标志检索，获取加工用地理标志原料的数据、专用标志使用数据，约定原料合规性承诺。

d. 集成电路布图设计数据

权利归属约定：梳理芯片协作开发全流程可能产生的各项成果，包括架构文档、模块设计、集成方案、验证套件、测试程序及最终版图数据等，明确各项成果是构成技术秘密、著作权还是潜在的布图设计，并基于各方贡献约定其归属。

7. 涉外知识产权

（1）利用目的

规避境外知识产权风险，保障企业海外业务（投资、参展、市场拓展）顺利开展，提升企业在国际市场的知识产权竞争力。

（2）利用方式

①境外投资风险分析

a. 专利数据

目标市场法律环境与技术壁垒分析：分析目标投资市场在相关技术领域的专利法律环境，包括专利审查标准、保护强度、诉讼倾向、法院判赔额度和禁令颁发难易度。同时，分析该领域核

心专利的分布，识别是否被当地企业或跨国公司高度垄断。判断在目标市场通过自主研发或技术引进实现商业化的法律难度和潜在诉讼风险，明确可能面临的主要专利壁垒及持有人。

供应链与自由实施（FTO）分析：若投资涉及在目标市场设立生产基地或采购链，需分析计划使用的设备、工艺、核心零部件在目标市场及产品潜在销售市场的专利布局情况，进行供应链端的 FTO 分析，识别在目标市场制造、销售产品可能面临的专利侵权风险，评估风险的可控性。

b. 商标数据

商标本土化与在先权利冲突分析：分析拟在目标市场使用的商标是否与当地已注册商标或在先使用的商标构成冲突。同时，研究目标市场的商标审查实践、文化禁忌及消费者认知习惯。评估商标在目标市场获得注册和使用的法律风险，识别潜在的异议方或诉讼方，明确商标本土化策略是否需要调整。

c. 地理标志数据

供应链与合规风险分析：若投资涉及在目标市场建立生产基地、采购原料或销售地理标志产品，需分析目标市场及产品潜在销售市场的地理标志相关要求，包括产地溯源标准、质量管控规范、专用标志使用限制等，排查供应链各环节的地理标志合规风险，识别因产地不符、品质不达标、标志使用不当可能引发的处罚或侵权纠纷，评估风险的可控性及应对难度。

d. 集成电路布图设计数据

权利权属与稳定性调查: 若投资涉及收购境外芯片设计公司或相关技术资产, 需对其核心布图设计的登记情况、权属链条、技术依赖进行深度核查, 评估拟收购技术资产的核心价值及风险。

②海外参展风险分析

a. 专利数据

参展产品侵权风险分析: 参展前, 针对计划展出的产品, 检索和分析展会所在地的有效专利, 重点关注展会所在地竞争对手、行业等相关专利, 评估产品的现场演示、功能说明是否可能构成对当地专利的侵权。识别参展产品可能落入哪些当地专利的权利要求范围, 评估被竞争对手在展会现场申请临时禁令、导致展品被查封的即时风险等级, 并锁定高风险专利的权利人。

竞争对手情报分析: 监控主要竞争对手是否就同类技术在展会所在地申请了专利, 尤其是外观设计专利或实用新型专利, 并分析其是否曾在当地展会有过申请执法、投诉或提起诉讼的历史。了解竞争对手的知识产权策略和维权活跃度, 预警其可能利用展会平台发起知识产权争议。

b. 商标数据

商标使用风险排查: 排查所有计划携带出境的展品、宣传册、海报、视频、赠品及展台设计方案中使用的商标是否在展会所在地已获得合法注册或授权, 并排查是否存在与当地知名商标构成混淆性近似的风险。

c. 地理标志数据

产地与质量表述的精准性核查：对涉及特定产地的展品，核查其在宣传中使用的产地名称、原产地标志、传统工艺描述，是否与产品真实来源地及加工工艺完全一致，并分析该名称在展会所在地是否为受保护的地理标志。判断宣传口径是否准确、合法，是否存在虚假原产地宣传、不当关联或侵犯其他地理标志的风险。

d. 集成电路布图设计数据

参展前侵权风险分析：参展前，针对计划展出的芯片产品，检索展会所在地已登记的集成电路布图设计，重点关注展会所在地主要竞争对手及行业核心企业的布图设计布局。评估芯片展品的现场演示、技术参数披露、设计方案介绍是否可能构成对当地布图设计专有权的侵权。

展会材料合规性核查：核查参展过程中拟使用的芯片照片、结构示意图、设计文档演示等宣传材料，评估其是否可能构成对他人布图设计专有权的间接侵权或技术秘密泄露风险。明确需采取物理遮蔽、信息脱敏处理的敏感设计模块，制定展台技术保密方案。

③ 境外市场进入风险分析

a. 专利数据

目标市场专利壁垒与自由实施（FTO）分析：分析目标市场在相关技术领域的专利布局全景，包括主要专利权人、核心专利的保护范围与法律稳定性、技术发展趋势以及该市场的专利诉讼活跃度与判赔倾向。评估进入该市场面临的专利竞争强度与法律

风险等级，明确产品在当地销售是否可能侵犯现有专利权，识别潜在的高风险诉讼方，并判断是否存在通过技术规避或许可谈判来化解风险的可行路径。

b. 商标数据

商标可注册性与在先权利冲突的预判分析：在目标市场对拟使用的商标进行检索，排查是否存在相同或近似的在先注册商标或已形成市场声誉的在先使用商标。预测商标在目标市场获得注册的可能性及主要障碍，识别潜在的异议方或诉讼方，评估商标修改或进行共存谈判的必要性与成本。

c. 地理标志数据

目标市场地理标志保护模式与名称冲突分析：分析目标市场对地理标志的保护模式（如专门法保护、商标法保护或双边协定互认）、保护范围及执法机制。检索目标市场已注册或受保护的地理标志清单，评估拟使用的产品名称、产地标识是否与当地地理标志构成相同或近似，是否可能因通用名称化等原因被拒绝注册或遭遇侵权指控。

d. 集成电路布图设计数据

目标市场布图设计保护制度与登记可行性分析：分析目标市场对集成电路布图设计的保护模式（如是否实行登记制、是否承认互惠原则或首次商业实施地原则）、保护期限、独创性审查标准以及侵权判定规则。评估本企业布图设计在目标市场获得登记保护的可能性，预判因制度差异（如部分国家不保护仅用于掩模

制造的布图设计)导致的权利缺失风险。

(三) 知识产权合规管理

基于策划、支持等过程的分析结果,结合数据分析,对知识产权基础管理和经营管理过程开展合规审查和调查。

1. 合规审查

(1) 利用目的

结合知识产权数据,核查企业在基础管理和经营管理过程中的行为是否符合相关法律法规、政策要求及内部规定,识别潜在的违规风险。

(2) 利用方式

① 基础管理过程的合规审查

a. 专利数据

专利申请与维护流程的审查:核查本企业专利申请流程,包括发明人认定与署名是否真实、准确、无争议;专利申请文件的撰写是否规范;专利年费的缴纳是否及时,有无因疏忽导致权利失效的记录;海外专利申请是否遵守了相关国家关于技术出口管制的法律法规等。识别专利申请源头、过程和维护中存在的合规漏洞与潜在法律风险,明确是否存在虚假申请、权属纠纷隐患、非正常申请行为以及权利意外丧失的具体案例等。

b. 商标数据

商标使用、续展与信息变更的审查:核查商标在实际商业活动中的使用情况,核查使用证据是否完整、连续,使用范围是否

与注册核准范围一致,是否存在自行改变注册商标图样的行为等。同时,检查商标续展手续是否在法定期限内完成,注册人名义、地址等信息变更是否及时向商标局办理备案。诊断商标维持有效的核心风险点。

c. 地理标志数据

授权使用与质量控制体系运行的审查:检索地理标志公告及专用标志使用企业名录,核查本企业使用地理标志产品/商标名称或专用标志是否经过合法授权,生产过程记录、原料采购凭证、产品质量检验报告是否齐全且符合保护要求等。

d. 集成电路布图设计数据

专有权获取与维护过程的审查:通过布图设计专有权公告检索,核查布图设计从概念提出、逻辑设计、版图实现到最终定稿的全过程,是否保存了完整的、能够证明其独创性和创作时间的证据材料。核查本企业生产、销售的集成电路产品是否使用了他人受保护的布图设计,规避非法复制风险。

② 经营管理过程的合规审查

a. 专利数据

全链条审查:核查研发立项前是否执行了专利检索与风险分析;评估对外合作研发或技术委托合同中,专利权归属、侵权责任条款的完整性与公平性;核查关键设备采购、技术引进过程中,是否落实了供应商筛选;分析生产流程与工艺是否与已获授权的专利技术方案一致,是否存在未经许可实施他人专利的情况等。

诊断本企业在经营管理过程中，专利相关合规制度的建立情况与执行效果，识别因流程缺失或执行不力导致的潜在侵权风险、权属纠纷及资产流失漏洞。

b. 商标数据

全链条审查：核查研发立项阶段拟使用商标的可注册性检索是否落实；评估商标注册、续展、变更、转让等流程的合规性，核查商标注册有效期及续展提醒机制的执行情况；核查对外商标许可、合作使用合同中权利归属、使用范围、保密义务、侵权责任条款的完整性与公平性；核查所有对外宣传物料、产品包装、参展方案及电商平台、线下门店等销售渠道中商标的实际使用是否统一、规范，是否存在商标淡化、滥用等问题。诊断本企业在经营管理过程中商标使用与管理的合规制度建立情况及执行效果，识别因流程缺失或执行不力导致的商标失效、侵权纠纷、品牌声誉受损等潜在风险。

c. 地理标志数据

全链条审查：核查原料采购环节供应商的产地资质及原料溯源记录，确保原料来源符合地理标志产地范围要求；评估生产、加工环节是否遵守地理标志产品保护要求，生产记录、质量检测报告是否完整可追溯；核查地理标志专用标志的申请、使用是否合规，是否存在未经授权使用、伪造专用标志等情况；核查对外合作、委托加工合同中地理标志使用权限、合规责任、产地溯源要求等条款的完整性与公平性；核查产品包装、宣传物料中关于

地理标志、产地、质量特色的表述是否真实准确，以及其他可能涉及的问题。诊断本企业在经营管理过程中合规制度的建立情况及执行效果，识别因流程缺失或执行不力导致的合规处罚、地理标志品牌受损等潜在风险。

d. 集成电路布图设计数据

全链条审查：核查立项、研发、交付全流程管理规范，包括关键节点是否执行了侵权风险评估，设计工具及第三方 IP 核的引入是否签署合规授权协议，委托或合作开发合同中权属与保密条款是否完备。重点核查核心设计人员的劳动合同、保密协议、竞业限制协议的有效性，核查员工入职、在职、离职过程中的权利归属确认、设计资产交接及技术秘密保护记录。诊断本企业在经营管理过程中布图设计合规制度的建立情况及执行效果，识别因流程缺失、权属不清、人才流动管理疏漏导致的布图设计资产流失、侵权风险及技术秘密泄露隐患。

2. 调查过程

（1）利用目的

若合规审查发现涉嫌或实际的违规情形，则由具备相应能力的人员独立进行调查，通过知识产权数据分析作出结论，向最高管理者或管理者代表报告调查的次数和结果。

（2）利用方式

① 专利数据

进行侵权风险对比分析，将涉嫌侵权的技术方案与目标专利

的权利要求进行特征比对；检索并分析涉事专利的复审、无效决定信息，评估其权利稳定性并上报。

② 商标数据

检索涉事商标的注册公告、异议、无效宣告及行政诉讼数据，评估商标冲突状况与法律风险并上报。

③ 地理标志数据

核查地理标志产品/商标的产地范围、质量技术要求等公告信息，并与企业实际产品进行比对，判断是否符合规范并上报。

④ 集成电路布图设计数据

获取并分析涉嫌侵权的布图设计与已登记专有权保护的布图设计，进行实质性相似比对，评估其权利稳定性并上报。

六、绩效评价

（一）分析与评价

1. 利用目的

对策划、支持、运行等各过程的数据进行分析，利用分析结果评价知识产权价值实现的符合性、策划实施的有效性、知识产权合规管理体系的绩效及改进需求等。

2. 利用方式

（1）专利数据

价值实现的符合性评价：分析专利组合与主营产品/核心业务的关联覆盖度、专利实施转化率、许可转让收益及质押融资实现金额，评价专利资产价值创造与预期目标的符合程度。

策划实施的有效性评价：对比分析专利申请量、授权率、海外布局覆盖率和年度目标计划的偏差，评价专利布局策划在各研发项目、各技术分支的执行落地效果。

绩效与改进需求识别：统计专利法律状态维护失误率、侵权风险预警成功率及FTO 排查覆盖率，评价管理体系的运行绩效；通过分析驳回审查意见共性原因及竞争对手企业的专利动态变化，识别改进机会。

（2）商标数据

价值实现的符合性评价：分析本企业核心商标的市场知名度变化、品牌溢价贡献度及商标延伸至新业务领域的注册覆盖率，评价商标资产价值实现与品牌目标的符合程度。

策划实施的有效性评价：对比分析商标注册成功率、海外布局关键市场覆盖数与年度目标计划的偏差，评价商标布局策划在各商品/服务类别、各地域市场的执行落地效果。

绩效与改进需求识别：统计商标续展及时率、侵权线索处理时效及异议无效案件应对胜诉率，评价管理体系的绩效；通过分析驳回异议共性原因及行业商标申请趋势变化，识别改进机会。

（3）地理标志数据

策划实施的有效性评价：对比分析专用标志申请获取进度、品质管控标准执行覆盖率和年度目标计划的偏差，评价地理标志策划在产地溯源、生产规范等环节的执行落地效果。

绩效与改进需求识别：统计专用标志违规使用频次、质量检

测偏差率及整改闭环率，评价管理体系的运行绩效；通过分析政策法规变化及产地资源动态变化，识别改进机会。

（4）集成电路布图设计数据

价值实现的符合性评价：分析核心布图设计对芯片产品性能的贡献度、对外授权许可收益及技术自主化率，评价布图设计资产价值实现与目标的符合程度。

策划实施的有效性评价：对比分析布图设计登记覆盖率、产品“应登尽登”完成度与年度目标计划的偏差，评价布图设计保护策划在各产品线、各技术路线的执行落地效果。

绩效与改进需求识别：统计布图设计侵权排查遗漏率、权属纠纷发生率等，评价合规管理体系的绩效；通过分析技术路线图变化及行业纠纷案例共性原因，识别改进机会。

（二）内部审核

1. 利用目的

选择审核员并依据策划的要求开展内部审核，确保知识产权合规管理体系有效实施和保持。

2. 利用方式

（1）专利数据

专利数量审核：逐项审核知识产权目标与实际完成专利产出进行比对。同时，检查已获授权专利的法律状态维护及时性、决策流程规范性。量化各研发项目在专利目标达成方面的完成率与质量偏差。

专利质量审核：审核本企业内部专利提案评估、专利文件撰写质量核查、第三方代理机构管理等流程的执行记录，抽查已申请专利的文件质量，并回溯内部评审意见，判断内部专利质量管控流程的有效性，识别因流程执行不力或标准缺失导致的问题。

（2）商标数据

商标使用审核：审核各业务单元、产品线商标实际使用与注册信息的一致性。核查商标注册申请计划与业务发展的匹配度，评估商标注册策略对业务拓展的支撑效果，识别不规范使用行为与注册策略的保护空白或滞后问题。

风险监测审核：核查商标监测报告、侵权线索的处理记录和维权案件档案，评估从发现侵权线索到启动法律行动的平均响应时间、处理结果以及资源投入产出比。判断商标风险监控体系是否灵敏、有效，维权行动是否主动、高效。

（3）地理标志数据

使用资质与质量控制审核：通过专用标志核准公告检索获取使用企业名单，与本企业使用资质比对，核查使用的合规性。结合产品检测报告，检查产品是否与保护要求的感官特色、理化指标等技术要求保持一致。

（4）集成电路布图设计数据

成果登记审核：审核项目从完成到提交布图设计登记的决策流程与时间记录，检查所有重要芯片产品是否应登尽登，登记材料的准备与提交是否规范，评估企业保护核心设计成果的力度。

（三）管理评审

1. 利用目的

最高管理者按照策划的要求开展管理评审，以确保知识产权合规管理体系的适宜性、充分性和有效性，与其战略方向一致。

2. 利用方式

（1）专利数据

专利整体效益评审：分析周期内专利组合对主营业务的收入贡献、风险规避价值以及资产运营收入。同时，评审专利全生命周期管理的总成本投入，计算其投入产出比和资产回报率。从财务和战略层面综合评价专利工作的整体效益与效率。

企业应对能力评审：综合评审技术趋势分析、竞争对手动态、主要市场法律环境变化，对比本企业专利布局的应对与适应情况，评估现有专利团队、流程和系统是否能够有效支持未来更复杂的竞争与合规要求，判断本企业专利体系的外部响应能力与内部支撑能力是否充足，识别战略缺口与能力短板。

（2）商标数据

商标价值评审：评审核心商标的法律状态、市场认知度与美誉度等数据，分析商标布局是否完整覆盖现有及未来规划的所有业务线与地域市场，判断商标是否为本企业当前市场地位提供了坚实支撑，并为未来扩张预留了充足的法律空间。

（3）地理标志数据

产地生态与合规体系评审：综合分析产地环境保护、原料供

应稳定性、质量指标达标率及地理标志法律环境变化，评估本企业现有产地管理流程、供应链追溯系统及风险应对机制的有效性。判断企业地理标志管理体系是否能够支撑未来产能扩张、跨区域合作及国际化的战略需求，识别产地生态风险与合规管理短板。

（4）集成电路布图设计数据

布图设计资产效益评审：评审布图设计对企业核心芯片产品的技术贡献度，在委托开发、合作项目中的权利收益，以及通过授权、转让等方式产生的资产运营收入。同时，核算布图设计在研发投入、登记维护等方面的总成本，计算投入产出比和资产回报率，从技术、财务和战略层面综合评价整体效益与管理效率。

七、改进

（一）识别改进机会

1. 利用目的

基于绩效评价的结果，结合数据分析，识别企业的改进机会，为不合格项整改及纠正措施的制定提供数据支撑。

2. 利用方式

（1）专利数据

资产质量与资源投入偏差分析：分析专利组合中授权专利与申请专利的比例、不同法律状态专利的分布、维持年限结构以及在不同技术分支和地域上的投入与产出对比，识别出高申请量但低授权率的领域以及资源投入与战略重要性不匹配的领域。

外部威胁变化与内部防御漏洞分析：对比分析主要竞争对手

近期专利布局重点、诉讼动态与本企业在相应技术领域或地域的专利保护强度与覆盖度，识别在关键技术点与市场区域存在的保护空白或薄弱环节，预警潜在专利壁垒及侵权诉讼高风险区。

（2）商标数据

注册成功率与流程效率分析：按类别、地域、代理方等多维度分析商标注册申请的驳回率、异议率及平均审查周期，识别商标注册流程中的高失败率环节、耗时瓶颈以及导致申请受阻的常见错误或策略失误。

（3）地理标志数据

产品优化策略分析：基于地理标志市场表现分析优化产品策略。利用产品质量检测偏差数据、专用标志违规使用频次数据等识别改进重点。

（4）集成电路布图设计数据

登记策略与核心成果覆盖度分析：检索已上市或在研的产品与其对应的布图设计登记情况，分析是否所有产品及其关键模块均已进行了登记，识别应登记未登记的保护短板。

（二）不合格和纠正措施

1. 利用目的

利用知识产权数据，对已发生的不合格或不合规问题进行深入调查和根源分析。

2. 利用方式

（1）专利数据

授权率与审查意见分析：统计特定时期、特定技术领域或特定代理机构经手的专利申请的授权率，并深入分析被驳回或发出审查意见通知书（OA）的案例，总结驳回或发出 OA 的主要理由。识别出授权率显著低于平均水平的申请群体或处理环节，明确导致申请失败的共性技术问题或撰写缺陷。

年费漏缴与权利失效分析：调查所有因未按时缴纳年费而导致专利权失效的案例，追溯其管理流程中哪个环节出现疏漏，并分析失效专利的原有价值。明确导致权利意外丧失的直接责任环节与根本原因，评估资产损失程度。

（2）商标数据

驳回/异议案件分析：对近期所有遭遇驳回或被提起异议的商标申请进行案例复盘，分析具体的法律依据，并回溯申请前的检索与风险评估过程，判断驳回或异议是由于无法避免的客观风险，还是因申请前的检索不充分、风险评估不当或策略选择失误等原因所致。

（3）地理标志数据

产品不合规分析：通过授权信息核查确认使用资质，通过产品质量检测数据分析违规原因。用整改后质量达标率验证效果。

（4）集成电路布图设计数据

登记策略分析：清查已上市销售或完成研发的产品，核对布图设计登记情况，识别出“应登未登”或登记范围未能充分保护创新点的“不合格”案例，明确因流程遗漏或策略判断失误导致

的保护漏洞，评估这些漏洞使本企业面临的技术被仿制风险。

（三）持续改进

1. 利用目的

结合分析与评价、管理评审等过程的分析结果，持续识别新的需求和机遇。通过数据驱动不断优化知识产权合规管理体系。

2. 利用方式

（1）专利数据

资产组合动态价值评估：结合技术、市场和法律环境的最新变化，对专利组合进行价值重估和风险复审。分析专利的实施率、许可潜力、防御价值与维持成本，并与本企业最新的战略重点进行匹配，识别出价值已显著提升需重点维护的专利、价值萎缩或战略关联度下降的专利以及需要新增布局的技术空白点。

（2）商标数据

商标申请策略分析：长期跟踪并分析本企业在不同国家/地区、不同商品/服务类别上的商标注册成功率、驳回原因、异议案件焦点及审查周期数据。同时，监测行业内的商标申请趋势与竞争态势变化。总结出适应特定市场、特定行业的最佳申请策略与实践经验，识别潜在的新兴注册风险领域或机会窗口。

（3）地理标志数据

合规使用与价值提升优化分析：长期跟踪分析地理标志政策、产地资源、市场需求与竞争态势，动态开展合规复审与价值重估；围绕品质达标率、标志使用率、市场溢价、供应链适配及管理成

本等，结合企业战略识别合规与品控关键提升节点；总结地理标志合规管理、品质管控等实践经验，优化产地溯源、质量检测及专用标志管理制度。

（4）集成电路布图设计数据

前瞻布局分析：监控全球集成电路技术路线图、新兴应用领域对芯片设计的新要求以及开源硬件生态的发展。结合技术发展态势、行业动态、纠纷案例等数据，识别下一代布图设计的关键技术节点与潜在创新方向，优化本企业布图设计的研发立项与布局策略，确保设计能力与产业升级节奏保持同步。